

日

庁

JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application: 2002年 9月10日

出願番号

Application Number: 特願2002-264114

[ST.10/C]:

[JP2002-264114]

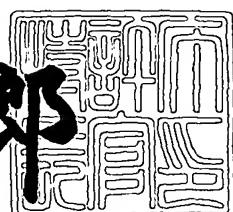
出願人

Applicant(s): 富士写真フィルム株式会社

2003年 4月 1日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3023144

【書類名】 特許願  
【整理番号】 FF837330  
【提出日】 平成14年 9月10日  
【あて先】 特許庁長官 殿  
【国際特許分類】 B41N 1/08  
B41N 3/03  
【発明の名称】 平版印刷版用支持体および平版印刷版原版  
【請求項の数】 3  
【発明者】  
【住所又は居所】 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写真フィルム株式会社内  
【氏名】 澤田 宏和  
【発明者】  
【住所又は居所】 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写真フィルム株式会社内  
【氏名】 上杉 彰男  
【特許出願人】  
【識別番号】 000005201  
【氏名又は名称】 富士写真フィルム株式会社  
【代理人】  
【識別番号】 100080159  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 渡辺 望穂  
【電話番号】 3864-4498  
【選任した代理人】  
【識別番号】 100090217  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 三和 晴子  
【電話番号】 3864-4498

【選任した代理人】

【識別番号】 100112645

【弁理士】

【氏名又は名称】 福島 弘薰

【電話番号】 3864-4498

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 006910

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0105042

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 平版印刷版用支持体および平版印刷版原版

【特許請求の範囲】

【請求項1】

原子間力顕微鏡を用いて、表面の  $50 \mu\text{m}$ □を  $512 \times 512$  点測定して求められる3次元データより得られる表面積比  $\Delta S^{50}$  が、下記条件 (i) ~ (iii) を満足する平版印刷版用支持体。

(i) 表面積比  $\Delta S^{50(50)}$  が  $20 \sim 90\%$

(ii) 表面積比  $\Delta S^{50(2-50)}$  が  $1 \sim 30\%$

(iii) 表面積比  $\Delta S^{50(0.2-2)}$  が  $5 \sim 40\%$

ここで、 $\Delta S^{50}$  は、前記3次元データから近似三点法により求められる実面積  $S_x^{50}$  と、幾何学的測定面積  $S_0^{50}$  とから、下記式により求められる。

$$\Delta S^{50} = [(S_x^{50} - S_0^{50}) / S_0^{50}] \times 100 (\%)$$

$\Delta S^{50(50)}$  は、前記3次元データから得られる表面積比であり、

$\Delta S^{50(2-50)}$  は、前記3次元データから波長  $2 \mu\text{m}$  以上  $50 \mu\text{m}$  以下の成分を抽出して得られる表面積比であり、

$\Delta S^{50(0.2-2)}$  は、前記3次元データから波長  $0.2 \mu\text{m}$  以上  $2 \mu\text{m}$  以下の成分を抽出して得られる表面積比を表す。

【請求項2】

表面に存在する深さ  $4 \mu\text{m}$  以上の凹部の数が  $400 \mu\text{m} \times 400 \mu\text{m}$  当たり 10 個以下であり、かつ、

表面に存在する深さ  $3 \mu\text{m}$  以上の凹部の数が  $400 \mu\text{m} \times 400 \mu\text{m}$  当たり 30 個以下である、請求項1に記載の平版印刷版用支持体。

【請求項3】

請求項1または2に記載の平版印刷版用支持体上に、画像記録層を設けてなる平版印刷版原版。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は平版印刷版用支持体および平版印刷版原版に関し、特に、保水性が優れるため、平版印刷版としたときに、網点部のインキ絡みが発生しにくく低湿度環境下における耐放置汚れ性に優れる平版印刷版用支持体およびそれに用いる平版印刷版原版に関する。

また、本発明は、上述した特性に加えて、ポツ状残膜が発生しにくい平版印刷版原版およびそれに用いられる平版印刷版用支持体に関する。

#### 【0002】

##### 【従来の技術】

平版印刷法は水と油が本質的に混じり合わないことを利用した印刷方式であり、これに使用される平版印刷版の印刷版面には、水を受容して油性インキを反撥する領域（以下、この領域を「非画像部」という。）と、水を反撥して油性インキを受容する領域（以下、この領域を「画像部」という。）とが形成される。

#### 【0003】

平版印刷版に用いられる平版印刷版用アルミニウム支持体（本発明において、単に「平版印刷版用支持体」という。）は、その表面が非画像部を担うように使用されるため、親水性および保水性が優れていること、更にはその上に設けられる画像記録層との密着性が優れていること等の相反する種々の性能が要求される。

支持体の親水性が低すぎると、印刷時に非画像部にインキが付着するようになり、プランケット胴の汚れ、ひいてはいわゆる地汚れが発生する。また、支持体の保水性が低すぎると、印刷時に湿し水を多くしないとシャドー部のつまりが発生する。よって、いわゆる水幅が狭くなる。

#### 【0004】

また、一方で、粗面化処理を施された支持体の表面に深い凹部が存在すると、その部分の画像記録層の厚みが厚くなるため、形状的に現像が抑制される場合がある。そして、現像が抑制された結果、画像記録層が深い凹部の中に残ってしまい、非画像部に局部的な残膜（以下、「ポツ状残膜」ともいう。）が発生し、印刷時の非画像部の汚れの原因となってしまうという問題がある。例えば、光熱変換により発生する熱によりアルカリ現像液に対する可溶性が変化するいわゆるサ

ーマルタイプの画像記録層を設けた平版印刷版原版においては、凹部の底部で画像形成反応が不十分となり、ポツ状残膜が発生する。

このようなポツ状残膜は、露光および現像の条件が厳しい場合に発生しやすい。例えば、サーマルタイプの画像記録層を設けた平版印刷版原版において、生産性の向上のために露光時間を短くしたり、レーザの長寿命化のためにレーザ光エネルギーを低くしたりするなど、レーザの露光量を低くする場合である。また、感度の高い高活性な現像液に対して、本来、画像部となるべき部分に画像抜けが発生しやすい画像記録層を用いるために、感度の低い現像液を用いて現像する場合などもある。

#### 【0005】

これらの性能の良好な平版印刷版用支持体を得るために、アルミニウム板の表面を砂目立て（粗面化処理）して凹凸を付与するのが一般的である。この凹凸については下記に示すように、様々な形状（構造）が提案されている。

例えば、中波と小波の開口径を規定した大波、中波および小波を有する3重構造（特許文献1参照。）、大小の2重構造において小波の径を規定する構造（例えば、特許文献2、特許文献3参照。）、大小の2重の凹部（ピット）に加えて更に微小な突起を付与する技術（特許文献4参照）、開口径を規定した2重構造（特許文献5参照。）、表面の滑らかさを示す因子 $a_{30}$ を規定した2重構造（特許文献6参照。）、および、複数の電気化学的粗面化処理（以下「電解粗面化処理」ともいう。）に際して重量されるピット径の比を規定した構造（特許文献7参照。）等が提案されている。

#### 【0006】

この砂目立てには、ポールグレイニング、ブラシグレイニング、ワイヤーグレイニング、ブラストグレイニング等の機械的粗面化方法、塩酸および／または硝酸を含む電解液中でアルミニウム板を電解エッチングする電解粗面化方法、および、機械的粗面化方法と電解粗面化方法を組み合わせた複合粗面化方法（特許文献8参照。）等が用いられている。

#### 【0007】

【特許文献1】 特開平8-300844号公報

- 【特許文献2】 特開平11-99758号公報
- 【特許文献3】 特開平11-208138号公報
- 【特許文献4】 特開平11-167207号公報
- 【特許文献5】 特許第2023476号明細書
- 【特許文献6】 特開平8-300843号公報
- 【特許文献7】 特開平10-35133号公報
- 【特許文献8】 米国特許第4,476,006号明細書
- 【0008】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、現在、印刷現場では、種々のインキが用途に応じて使用されており、それぞれのインキは異なる液物性を有する。上記従来技術においては、保水性が十分ではなく、インキや湿し水の種類によっては、特に画像部の中でも画像面積率の高い網点部（以下、「シャドー部」という。）で、印刷中に湿し水を減らした際に画像部のインキが非画像部に移動しやすくなる現象（以下、「網点部のインキ絡み」といい、この現象の発生し難さを「絡み難さ」という。）が発生しやすいという不具合を生じ、また耐放置汚れ性にも劣るという問題がある。この網点部のインキ絡みはインキと湿し水の物性の影響を非常に受けやすい。

したがって、本発明は、この問題を解決し、平版印刷版としたときに、インキや湿し水の種類によらず、網点部のインキ絡みが発生しにくく耐放置汚れ性に優れる平版印刷版用支持体およびそれを用いる平版印刷版原版を提供することを目的とする。

【0009】

また、保水性を向上させるには表面粗さを大きくすることが有効であるが、表面粗さを大きくすると、局所的に深い凹部が生じやすくなる。この深い凹部は、露光不良および現像不良の原因となり、ポツ状残膜が生じやすくなる。

したがって、本発明は、平版印刷版としたときに、インキや湿し水の種類によらず、網点部のインキ絡みが発生しにくく耐放置汚れ性に優れ、更に、ポツ状残膜が発生しない平版印刷版用支持体およびそれを用いる平版印刷版原版を提供することを目的とする。

## 【0010】

## 【課題を解決するための手段】

本発明者は、上記課題を解決すべく、平版印刷版用支持体の表面形状（物性）について鋭意検討した結果、表面積比 $\Delta S^{50}$ 、特に、原子間力顕微鏡を用いて、表面の $50 \mu m$ 口を $512 \times 512$ 点測定して求められる3次元データより得られる $\Delta S^{50(50)}$ 、該3次元データから波長 $2 \mu m$ 以上 $50 \mu m$ 以下の成分を抽出して得られる $\Delta S^{50(2-50)}$ 、および、該3次元データから波長 $0.2 \mu m$ 以上 $2 \mu m$ 以下の成分を抽出して得られる $\Delta S^{50(0.2-2)}$ を特定の範囲に調整することにより、親水性および保水性を改善でき、平版印刷版としたときに、網点部のインキ絡みが発生しにくく低温度環境下における耐放置汚れ性に優れることを知見した。

また、上記表面積比 $\Delta S^{50}$ を持つ平版印刷版用支持体の表面に存在する特定の深さを有する凹部の数を規定することにより、露光および現像の条件を厳しくしてもポツ状残膜の発生が特に抑えられることを知見した。

本発明者は、上記知見に基づき本発明を完成した。

## 【0011】

即ち、本発明は、以下の（1）～（3）を提供する。

## 【0012】

（1）原子間力顕微鏡を用いて、表面の $50 \mu m$ 口を $512 \times 512$ 点測定して求められる3次元データより得られる表面積比 $\Delta S^{50}$ が、下記条件（i）～（iii）を満足する平版印刷版用支持体。

（i）表面積比 $\Delta S^{50(50)}$ が $20 \sim 90\%$

（ii）表面積比 $\Delta S^{50(2-50)}$ が $1 \sim 30\%$

（iii）表面積比 $\Delta S^{50(0.2-2)}$ が $5 \sim 40\%$

ここで、 $\Delta S^{50}$ は、前記3次元データから近似三点法により求められる実面積 $S_x^{50}$ と、幾何学的測定面積 $S_0^{50}$ とから、下記式により求められる。

$$\Delta S^{50} = [(S_x^{50} - S_0^{50}) / S_0^{50}] \times 100 (\%)$$

$\Delta S^{50(50)}$ は、前記3次元データから得られる表面積比であり、

$\Delta S^{50(2-50)}$ は、前記3次元データから波長 $2 \mu m$ 以上 $50 \mu m$ 以下の成分を

抽出して得られる表面積比であり、

$\Delta S^{50(0.2-2)}$  は、前記3次元データから波長0.2  $\mu m$ 以上2  $\mu m$ 以下の成分を抽出して得られる表面積比を表す。

【0013】

(2) 表面に存在する深さ4  $\mu m$ 以上の凹部の数が400  $\mu m \times 400 \mu m$ 当たり10個以下であり、かつ、表面に存在する深さ3  $\mu m$ 以上の凹部の数が40個以下である、上記(1)に記載の平版印刷版用支持体。

ここで、上記表面に存在する深さ3  $\mu m$ 以上の凹部の数には、上記の深さ4  $\mu m$ 以上の凹部の数を含む。また、これらの深さは、前記3次元データの表面粗さ曲線の平均線を基準とするものである。

【0014】

(3) 上記(1)または(2)に記載の平版印刷版用支持体上に、画像記録層を設けてなる平版印刷版原版。

【0015】

【発明の実施の形態】

以下、本発明について詳細に説明する。

[平版印刷版用支持体]

〈表面の砂目形状〉

本発明の平版印刷版用支持体は、原子間力顕微鏡を用いて、表面の50  $\mu m$ を512  $\times$  512点測定して求められる3次元データより得られる表面積比 $\Delta S^{50}$ が、下記条件(i)～(iii)を満足する平版印刷版用支持体である。

(i) 表面積比 $\Delta S^{50(50)}$ が20～90%

(ii) 表面積比 $\Delta S^{50(2-50)}$ が1～30%

(iii) 表面積比 $\Delta S^{50(0.2-2)}$ が5～40%

ここで、 $\Delta S^{50}$ は、前記3次元データから近似三点法により求められる実面積

$S_x^{50}$ と、幾何学的測定面積 $S_0^{50}$ とから、下記式により求められる。

$$\Delta S^{50} = [(S_x^{50} - S_0^{50}) / S_0^{50}] \times 100 (\%)$$

$\Delta S^{50(50)}$ は、前記3次元データから得られる表面積比であり、

$\Delta S^{50(2-50)}$  は、前記3次元データから波長2  $\mu m$ 以上50  $\mu m$ 以下の成分を抽出して得られる表面積比であり、

$\Delta S^{50(0.2-2)}$  は、前記3次元データから波長0. 2  $\mu m$ 以上2  $\mu m$ 以下の成分を抽出して得られる表面積比を表す。

#### 【0016】

$\Delta S^{50}$  は、後に詳述するように、前記3次元データから近似三点法により求められる実面積  $S_x^{50}$  と、幾何学的測定面積（見掛け面積）  $S_0^{50}$  とから、下記式により求められる。

$$\Delta S^{50} = [ (S_x^{50} - S_0^{50}) / S_0^{50} ] \times 100 \text{ (%)}$$

表面積比  $\Delta S^{50}$  は、幾何学的測定面積  $S_0^{50}$  に対する粗面化処理による実面積  $S_x^{50}$  の増加の程度を示すファクターである。  $\Delta S^{50}$  が大きくなると、画像記録層との接触面積が大きくなる。

本発明では、表面積比  $\Delta S^{50}$  を、上記3次元データから得られる表面積比  $\Delta S^{50(50)}$ （全波長成分（実質的には0. 1～50  $\mu m$ の成分））と、上記3次元データから波長2  $\mu m$ 以上50  $\mu m$ 以下の成分を抽出して得られる表面積比  $\Delta S^{50(2-50)}$  と、上記3次元データから波長0. 2  $\mu m$ 以上2  $\mu m$ 以下の成分を抽出して得られる表面積比  $\Delta S^{50(0.2-2)}$  とを特定の範囲に調整することにより、上記課題を解決するものである。

#### 【0017】

上記表面積比を特定の範囲に調整すると上記課題が解決できる理由は、明確には解っていないが、次のように考えられる。

まず、平版印刷版用支持体の表面に存在する凹凸構造の表面積比  $\Delta S^{50(50)}$  が本発明の範囲内であると、該凹凸構造に保持される水量が多くなり、親水性および保水性を改善でき、網点部のインキ絡みを抑えることができる。

#### 【0018】

また、該凹凸構造の表面積比  $\Delta S^{50(2-50)}$  が本発明の範囲内であると、その上に設けられる画像記録層も該凹凸構造に沿って凹凸形状に形成され、その凹凸形状の凹部にインキが蓄えられやすくなる。そうすると、印刷時にプランケット胴により加圧（圧着）されても、該凹凸形状内でインキの移動を吸収できるため、

インキの広がりが抑えられ網点部のインキ絡みも抑えることができる。更に $\Delta S_{50(2-50)}$ が本発明の範囲内であると、砂目内にインキ成分や紙粉等の付着物が付いた場合でも、十分な保水量を保つことができる。更に、地汚れにも優れる。

## 【0019】

更に、該凹凸構造の表面積比 $\Delta S^{50(0.2-2)}$ が本発明の範囲内であると、その上に設けられる画像記録層が現像処理において完全に取り除かれやすく親水性が向上するため、網点部のインキ絡みが発生しにくくなり、耐放置汚れ性にも優れる。

## 【0020】

表面積比 $\Delta S^{50(50)}$ と、 $\Delta S^{50(2-50)}$ と、 $\Delta S^{50(0.2-2)}$ は上記のような作用を有すると考えられるが、これらは独立して該作用を有するのではなく相互に影響しあい全体として平版印刷版用支持体の保水性および親水性の向上等に寄与していると考えられる。

したがって、これらの表面積比 $\Delta S^{50(50)}$ と、 $\Delta S^{50(2-50)}$ と、 $\Delta S^{50(0.2-2)}$ とをそれぞれ上記の特定範囲にバランスよく調整することにより、平版印刷版用支持体の表面全体としての親水性および保水性を改善でき、平版印刷版としたときに、網点部のインキ絡みが発生しにくく低湿度環境下における耐放置汚れ性に優れる平版印刷版用支持体とすることができます。

## 【0021】

本発明においては、表面積比 $\Delta S^{50(50)}$ は20~90%であり、好ましくは30~85%、より好ましくは35~55%である。

表面積比 $\Delta S^{50(2-50)}$ は1~30%であり、好ましくは3~30%、より好ましくは5~10%である。

表面積比 $\Delta S^{50(0.2-2)}$ は5~40%であり、好ましくは5~35%である。

## 【0022】

一方、保水性および親水性を改善するため、上記全波長成分の表面積比 $\Delta S^{50(50)}$ および長波長成分の $\Delta S^{50(2-50)}$ を大きくすると、ポツ状残膜発生の原因となる深くて大きい凹部が局所的に生じやすくなる場合がある。

そのため、特に、露光および現像の条件を厳しくするとポツ状残膜の発生が認

められる傾向がある。このような条件においても、ポツ状残膜の発生を特に抑えられる平版印刷版原版および平版印刷版用支持体が望まれている。

上記の各表面積比 $\Delta S^{50}$ を満足する平版印刷版用支持体の表面に存在する深さ $4 \mu m$ 以上の凹部の数が $400 \mu m \times 400 \mu m$ 当たり10個以下とし、かつ、表面に存在する深さ $3 \mu m$ 以上の凹部の数が $400 \mu m \times 400 \mu m$ 当たり30個以下とすると、上記条件においても、ポツ状残膜の発生を特に抑えられることを見出したのである。

#### 【0023】

$4 \mu m$ 以上の深さを持つ局所的な凹部は、画像記録層が露光・現像処理で除去し難く、ポツ状残膜の発生に影響を与えるため、本発明では、平版印刷版用支持体の表面に存在する深さ $4 \mu m$ 以上の凹部の数を $400 \mu m \times 400 \mu m$ 当たり10個以下とするのが好ましく、6個以下とするのがより好ましく、4個以下とするのが特に好ましい。

また、 $3 \mu m$ 以上の深さを持つ局所的な凹部は、画像記録層が露光・現像処理で完全に除去されない場合があり、ポツ状残膜の発生に影響を与えるため、本発明では、平版印刷版用支持体の表面に存在する深さ $3 \mu m$ 以上の凹部の数を $400 \mu m \times 400 \mu m$ 当たり30個以下とするのが好ましく、20個以下とするのがより好ましく、15個以下とするのが特に好ましい。

#### 【0024】

このような表面形状を形成させるには、例えば、硝酸を主体とする電解液を用いた電解粗面化処理においてアノード反応にあずかる電気量の総和を大きくする方法、ブラシロールと特定のメジアン径を持つ研磨剤を用いる機械的粗面化処理を行う方法等が挙げられる。

#### 【0025】

本発明の平版印刷版用支持体において、表面積比 $\Delta S^{50(50)}$ 、 $\Delta S^{50(2-50)}$ 、 $\Delta S^{50(0.2-2)}$ および上記特定深さの凹部の数（本発明において、「表面形状を表すファクター」という場合がある。）の測定方法は、以下の通りである。

#### 【0026】

（1）①原子間力顕微鏡による表面積比 $\Delta S^{50}$ の測定

本発明においては、原子間力顕微鏡（A t o m i c F o r c e M i c r o s c o p e : A F M）により表面形状を測定し、3次元データを求める。

測定は、例えば、以下の条件で行うことができる。

即ち、平版印刷版用支持体を1cm角の大きさに切り取って、ピエゾスキャナー上の水平な試料台にセットし、カンチレバーを試料表面にアプローチし、原子間力が働く領域に達したところで、XY方向にスキャンし、その際、試料の凹凸をZ方向のピエゾの変位でとらえる。ピエゾスキャナーは、XY方向について150μm、Z方向について10μm、走査可能なものを使用する。カンチレバーは共振周波数120～400kHz、バネ定数12～90N/mのもの（SIRDF20、セイコーインスツルメンツ社製、NCH-10、NANOSENDRS社製、または、AC-160TS、オリンパス社製）を用い、DFMモード（Dynamic Force Mode）で測定する。また、求めた3次元データを最小二乗近似することにより試料のわずかな傾きを補正し基準面を求める。

計測の際は、表面の50μm□を512×512点測定する。XY方向の分解能は0.1μm、Z方向の分解能は1nm、スキャン速度は60μm/secとする。

### 【0027】

#### ②△S<sup>50</sup>の測定

上記①で求められた3次元データ（f（x, y））を用い、隣り合う3点を抽出し、その3点で形成される微小三角形の面積の総和を求め、実面積S<sub>x</sub><sup>50</sup>とする。表面積比△S<sup>50</sup>は、得られた実面積S<sub>x</sub><sup>50</sup>と幾何学的測定面積S<sub>0</sub><sup>50</sup>とから、下記式により求められる。

$$\Delta S^{50} = [(S_x^{50} - S_0^{50}) / S_0^{50}] \times 100 (\%)$$

(i) △S<sup>50(50)</sup>の算出には上記①で求められた3次元データをそのまま用いる

(ii) 表面積比△S<sup>50(2-50)</sup>の算出には、上記①で求められた3次元データから波長2μm以上50μm以下の成分を抽出したものを用いる。波長2μm以上50μm以下の成分の抽出には、上記①で求められた3次元データを高速フーリエ変換する。

エ変換をして周波数分布を求め、ついで、波長  $2 \mu\text{m}$  未満の成分を除去した後、フーリエ逆変換をすることにより行う。

(iii) 表面積比  $\Delta S^{50(0.2-2)}$  の算出には、上記①で求められた3次元データから波長  $0.2 \mu\text{m}$  以上  $2 \mu\text{m}$  以下の成分を抽出したものを用いる。波長  $0.2 \mu\text{m}$  以上  $2 \mu\text{m}$  以下の成分の抽出には、上記①で求められた3次元データを高速フーリエ変換をして周波数分布を求め、ついで、波長  $0.2 \mu\text{m}$  未満の成分および  $2 \mu\text{m}$  超の成分を除去した後、フーリエ逆変換をすることにより行う。

#### 【0028】

##### (2) 特定深さの凹部の数

###### ①深さ $4 \mu\text{m}$ 以上の凹部の数

レーザ顕微鏡を用いて表面の  $400 \mu\text{m} \times 400 \mu\text{m}$  を非接触で  $0.01 \mu\text{m}$  走査して3次元データを求め、この3次元データにおいて深さ  $4 \mu\text{m}$  以上の凹部の数を数える。

###### ②深さ $3 \mu\text{m}$ 以上の凹部の数

同様に3次元データを求め、深さ  $3 \mu\text{m}$  以上の凹部の数を数える。

#### 【0029】

##### <表面処理>

本発明の平版印刷版用支持体は、後述するアルミニウム板に表面処理を施すことによって、上述した表面の砂目形状をアルミニウム板の表面に形成させたものである。本発明の平版印刷版用支持体は、アルミニウム板に粗面化処理を施して得られるが、この支持体の製造工程は、特に限定されず、粗面化処理以外の各種の工程を含んでいてもよい。

以下に、上述した表面の砂目形状を形成させるための代表的方法として、  
アルミニウム板に機械的粗面化処理、アルカリエッティング処理、酸によるデスマット処理および電解液を用いた電気化学的粗面化処理を順次施す方法、  
アルミニウム板に機械的粗面化処理、アルカリエッティング処理、酸によるデスマット処理および異なる電解液を用いた電気化学的粗面化処理を複数回施す方法

アルミニウム板にアルカリエッティング処理、酸によるデスマット処理および電

解液を用いた電気化学的粗面化処理を順次施す方法、  
 アルミニウム板にアルカリエッティング処理、酸によるデスマット処理および異  
 なる電解液を用いた電気化学的粗面化処理を複数回施す方法  
 が挙げられるが、本発明はこれらに限定されない。これらの方法において、前記  
 電気化学的粗面化処理の後、更に、アルカリエッティング処理および酸によるデス  
 マット処理を施してもよい。

本発明の平版印刷版用支持体の表面形状を表すファクターが、それぞれ特定の  
 条件を満足するようにするのに好適に用いられる粗面化処理としては、他の処理  
 (アルカリエッティング処理等) の条件にもよるが、例えば、硝酸を主体とする電  
 解液を用いた電解粗面化処理においてアノード反応にあずかる電気量の総和を大  
 きくする方法、ブラシロールと特定のメジアン径を持つ研磨剤を用いる機械的粗  
 面化処理を行う方法等が挙げられる。

## 【0030】

これらの方法等により得られ、表面形状を表す表面積比  $\Delta S^{50(50)}$ 、 $\Delta S^{50(2-50)}$  および  $\Delta S^{50(0.2-2)}$  が、それぞれ特定の条件を満足する本発明の平版印刷  
 版用支持体は、平版印刷版としたときに、インキや温し水の種類によらず、網点  
 部のインキ絡みが発生しにくく耐放置汚れ性に優れる。更に、特定深さを有する  
 凹部の数が特定の条件を満足すると、露光および現像の条件を厳しくしてもポツ  
 状残膜の発生を特に抑えることができる。

以下、表面処理の各工程について、詳細に説明する。

## 【0031】

## &lt;機械的粗面化処理&gt;

機械的粗面化処理は、電気化学的粗面化処理と比較してより安価に、平均波長  
 $2 \sim 100 \mu m$  の凹凸のある表面を形成することができるため、粗面化処理の手  
 段として有効である。

機械的粗面化処理方法としては、例えば、アルミニウム表面を金属ワイヤーで  
 ひっかくワイヤーブラシグレイン法、研磨球と研磨剤でアルミニウム表面を砂目  
 立てるボールグレイン法、特開平6-135175号公報および特公昭50-  
 40047号公報に記載されているナイロンブラシと研磨剤で表面を砂目立てす

るブラシグレイン法を用いることができる。

また、凹凸面をアルミニウム板に圧接する転写方法を用いることもできる。即ち、特開昭55-74898号、特開昭60-36195号、特開昭60-36196号、特開昭60-203496号、特開昭61-162351号、特公平4-30358号の各公報に記載されている方法のほか、転写を数回行うこととする特開平6-55871号公報、表面が弾性であることを特徴とした特願平4-204235号明細書（特開平6-024168号公報）に記載されており、方法も適用可能である。

後述するように、ブラシグレイン法では、特にナイロンブラシを複数用いるのが好ましく、研磨剤としては、後述の種々のものを用いることができるが、パミストン、ケイ砂、水酸化アルミニウム等を用いるのが好ましい。また、転写方法では、ブラシを回転させる駆動モータの回転数、負荷等を適宜調整するのが好ましい。

[0032]

また、放電加工、ショットブラスト、レーザ、プラズマエッティング等を用いて、微細な凹凸を食刻した転写ロールを用いて繰り返し転写を行う方法や、微細粒子を塗布した凹凸のある面を、アルミニウム板に接面させ、その上より複数回繰り返し圧力を加え、アルミニウム板に微細粒子の平均直径に相当する凹凸パターンを複数回繰り返し転写させる方法を用いることもできる。転写ロールへ微細な凹凸を付与する方法としては、特開平3-8635号、特開平3-66404号、特開昭63-65017号の各公報等に記載されている公知の方法を用いることができる。また、ロール表面にダイス、バイト、レーザ等を使って2方向から微細な溝を切り、表面に角形の凹凸をつけてもよい。このロール表面には、公知のエッティング処理等を行って、形成させた角形の凹凸が丸みを帯びるような処理を行ってもよい。

また、表面の硬度を上げるために、焼き入れ、ハードクロムメッキ等を行ってもよい。

そのほかにも、機械的粗面化処理としては、特開昭61-162351号公報、特開昭63-104889号公報等に記載されている方法を用いることもでき

る。

本発明においては、生産性等を考慮して上述したそれぞれの方法を併用することもできる。これらの機械的粗面化処理は、電気化学的粗面化処理の前に行うのが好ましい。

【0033】

以下、機械的粗面化処理として好適に用いられるブラシグレイン法について説明する。

ブラシグレイン法は、一般に、円柱状の胴の表面に、ナイロン（商標名）、プロピレン、塩化ビニル樹脂等の合成樹脂からなる合成樹脂毛等のブラシ毛を多数植設したローラ状ブラシを用い、回転するローラ状ブラシに研磨剤を含有するスラリー液を噴きかけながら、上記アルミニウム板の表面の一方または両方を擦ることにより行う。上記ローラ状ブラシおよびスラリー液の代わりに、表面に研磨層を設けたローラである研磨ローラを用いることもできる。

ローラ状ブラシを用いる場合、曲げ弾性率が好ましくは10,000~40,000 kg/cm<sup>2</sup>、より好ましくは15,000~35,000 kg/cm<sup>2</sup>であり、かつ、毛腰の強さが好ましくは500 g以下、より好ましくは400 g以下であるブラシ毛を用いる。ブラシ毛の直径は、一般的には、0.2~0.9 mmである。ブラシ毛の長さは、ローラ状ブラシの外径および胴の直径に応じて適宜決定することができるが、一般的には、10~100 mmである。

本発明では、ナイロンブラシは複数本用いるのが好ましく、具体的には、3本以上がより好ましく、4本以上が特に好ましい。ブラシの本数を調整することにより、アルミニウム板表面に形成される凹部の波長成分を調整できる。

また、ブラシを回転させる駆動モータの負荷は、ブラシローラをアルミニウム板に押さえつける前の負荷に対して1 kWプラス以上が好ましく、2 kWプラス以上がより好ましく、8 kWプラス以上が特に好ましい。該負荷を調整することにより、アルミニウム板表面に形成される凹部の深さを調整することができる。ブラシの回転数は、100回転以上が好ましく、200回転以上が特に好ましい。

【0034】

研磨剤は公知の物を用いることができる。例えば、パミストン、ケイ砂、水酸化アルミニウム、アルミナ粉、炭化ケイ素、窒化ケイ素、火山灰、カーボランダム、金剛砂等の研磨剤；これらの混合物を用いることができる。中でも、パミストン、ケイ砂が好ましい。特に、ケイ砂は、パミストンに比べて硬く、壊れにくいので粗面化効率に優れる点で好ましい。また、水酸化アルミニウムは過度の荷重がかかると粒子が破損するため、局所的に深い凹部を生成させたくない場合に好適である。

研磨剤のメジアン径は、粗面化効率に優れ、かつ、砂目立てピッチを狭くすることができる点で、 $2 \sim 100 \mu\text{m}$ であるのが好ましく、 $20 \sim 60 \mu\text{m}$ であるのがより好ましい。研磨剤のメジアン径を調整することにより、アルミニウム板表面に形成される凹部の深さを調整することができる。

研磨剤は、例えば、水中に懸濁させて、スラリー液として用いる。スラリー液には、研磨剤のほかに、増粘剤、分散剤（例えば、界面活性剤）、防腐剤等を含有させることができる。スラリー液の比重は $0.5 \sim 2$ であるのが好ましい。

機械的粗面化処理に適した装置としては、例えば、特公昭50-40047号公報に記載された装置を挙げることができる。

### 【0035】

以下、機械的粗面化処理として用いられる転写法の一例について説明する。

一般的に、転写法は、ショットブラスト処理や刻印やレーザー加工またはパターンエッチング等でエンボス加工した圧延ロール（転写ロール）にアルミニウム板を通して圧延ロールの凹凸を転写し、あるいは、紙またはプラスチックシートに研磨材やガラスピース等を塗布したものをアルミニウム板と重ね合わせて圧延して転写し、アルミニウム板を粗面化する方法である。

該転写法は、上記した方法以外に、以下の方法等を用いることができる。

転写ローラの圧下率を低く設定することにより転写ローラの寿命やアルミニウム板の延伸の問題を回避することができる方法（特開平7-205565号公報）；転写を複数回、好ましくは4回以上繰り返し行うことにより転写ロールの円筒度等の加工精度にこだわる必要もなく、アルミニウム板の伸びを少なくし、印刷版用アルミニウム支持体として十分均一な粗面が得られる方法（特開平6-5

5871号公報) ; 化学的に粗面化を行った、平版印刷版用アルミニウムより硬度の高い金属面に、アルミニウム板を1~6回プレスして粗面化することにより、ランダムな配列のしかも均一な分布の凹凸を安価につくることができる方法(特開平6-171258号公報) ; アルミニウム板の表面に方向性のない多数のプレス凹部を形成させる方法(特開平6-171256号公報、特開平6-171259号公報) ; 金属面上に塗布乾燥したフォトレジストまたはプラスチック樹脂を赤外光、レーザー等で露光、照射してレジストパターンをつくり、その後化学的なエッティング等を行い金属面上に粗面を作製し転写することにより、十分均一な凹凸を転写させる方法(特開平6-171262号公報) 等を用いることができる。

## 【0036】

転写法において、転写ロール等に設けられる凸部の大きさ(転写ロールの表面粗さ)と、該転写ロールにより転写されたアルミニウム板に形成される凹部の大きさ(転写法によるアルミニウム板の表面粗さ)は、ほぼ同じである。

したがって、アルミニウム板に、所望の該表面粗さを形成させるには、該表面粗さと略同一の表面粗さを有する転写ロール等を用いればよい。

転写ローラは、例えばSUS304やSUS316、SCM鋼、SUSJ鋼、S41等からなるローラ芯金の表面に、溶射やレーザ、あるいは機械加工等により微細な凸部を付与して構成される。

溶射による方法では、粒径10~60μm程度のセラミックス粒子やセラミックス焼結体を、プラズマ溶射やDJガンによる溶射、ワイヤによる溶射によりローラ表面に0.1~0.6mm程度の厚さにコーティングし、表面を研磨して得られる。セラミックスの種類としては、酸化クロムを主成分とする酸化物セラミックスや窒化ケイ素を主成分とする窒化物セラミックスが強度の点から好ましい。また、溶射により形成されたローラ表面は粗いため、研磨処理される。

一方、レーザにより凸部を形成する方法は、ローラ表面のレーザ照射部分が溶融して盛り上がることを利用するもので、レーザによりローラ表面に縦溝と横溝とを直交またはある角度をもって格子状に形成することで、両溝で切り取られた互いに独立した凸部を形成することができる。使用されるレーザは、CO<sub>2</sub>レー

ザやYAGレーザ、エキシマレーザ等を挙げることができる。また、レーザの種類により形成される溝幅が異なる。従って、所望する凸部の大きさに応じてレーザの種類を選択する必要があり、より微細な凹凸形状を持つ転写ローラを得るにはエキシマレーザ等の波長の短いレーザを使用する必要がある。また、ダイヤモンド砥石やセラミック砥石、あるいはこれらを含んだ研磨紙により仕上げられる

## 【0037】

同様に、ローラ表面にダイスやバイトを使って2方向から微細な溝を格子状に切り、角形の凹凸を付けることもできる。

アルミニウム板あるいはアルミニウム合金板は、前記転写ローラと鏡面仕上げされた金属ローラ（バックアップロール）との間に挿通されると共に、線圧下力3～30kg/mm程度の下で転写ローラの凸部からなる凹凸パターンが転写される。なお、詳細は、特開平7-205565号公報に記載されている。

該転写法における、組成物面化処理の条件は、所望の表面粗さにより、適宜調整することができる。

## 【0038】

## &lt;電気化学的粗面化処理&gt;

電気化学的粗面化処理には、通常の交流を用いた電気化学的粗面化処理に用いられる電解液を用いることができる。中でも、塩酸または硝酸を主体とする電解液を用いるのが、表面形状を表すファクターがそれぞれ特定の条件を満足するようにするのに好適である。

本発明における電解粗面化処理としては、陰極電解処理の前後に酸性溶液中の交番波形電流による第1および第2の電解処理を行うことが好ましい。陰極電解処理により、アルミニウム板の表面で水素ガスが発生してスマットが生成することにより表面状態が均一化され、その後の交番波形電流による電解処理の際に均一な電解粗面化が可能となる。

この電解粗面化処理は、例えば、特公昭48-28123号公報および英国特許第896,563号明細書に記載されている電気化学的グレイン法（電解グレイン法）に従うことができる。この電解グレイン法は、正弦波形の交流電流を用

いるものであるが、特開昭52-58602号公報に記載されているような特殊な波形を用いて行ってもよい。また、特開平3-79799号公報に記載されている波形を用いることもできる。また、特開昭55-158298号、特開昭56-28898号、特開昭52-58602号、特開昭52-152302号、特開昭54-85802号、特開昭60-190392号、特開昭58-120531号、特開昭63-176187号、特開平1-5889号、特開平1-280590号、特開平1-118489号、特開平1-148592号、特開平1-178496号、特開平1-188315号、特開平1-154797号、特開平2-235794号、特開平3-260100号、特開平3-253600号、特開平4-72079号、特開平4-72098号、特開平3-267400号、特開平1-141094号の各公報に記載されている方法も適用できる。また、前述のほかに、電解コンデンサーの製造方法として提案されている特殊な周波数の交番電流を用いて電解することも可能である。例えば、米国特許第4,276,129号明細書および同第4,676,879号明細書に記載されている。

### 【0039】

電解槽および電源については、種々提案されているが、米国特許第4,203,637号明細書、特開昭56-123400号、特開昭57-59770号、特開昭53-12738号、特開昭53-32821号、特開昭53-32822号、特開昭53-32823号、特開昭55-122896号、特開昭55-132884号、特開昭62-127500号、特開平1-52100号、特開平1-52098号、特開昭60-67700号、特開平1-230800号、特開平3-257199号の各公報等に記載されているものを用いることができる。

また、特開昭52-58602号、特開昭52-152302号、特開昭53-12738号、特開昭53-12739号、特開昭53-32821号、特開昭53-32822号、特開昭53-32833号、特開昭53-32824号、特開昭53-32825号、特開昭54-85802号、特開昭55-122896号、特開昭55-132884号、特公昭48-28123号、特公昭51-7081号、特開昭52-133838号、特開昭52-133840号、

特開昭52-133844号、特開昭52-133845号、特開昭53-149135号、特開昭54-146234号の各公報等に記載されているもの等も用いることができる。

## 【0040】

電解液である酸性溶液としては、硝酸、塩酸のほかに、米国特許第4, 671, 859号、同第4, 661, 219号、同第4, 618, 405号、同第4, 600, 482号、同第4, 566, 960号、同第4, 566, 958号、同第4, 566, 959号、同第4, 416, 972号、同第4, 374, 710号、同第4, 336, 113号、同第4, 184, 932号の各明細書等に記載されている電解液を用いることもできる。

## 【0041】

酸性溶液の濃度は0. 5~2. 5質量%であるのが好ましいが、下記のスマット除去処理での使用を考慮すると、0. 7~2. 0質量%であるのが特に好ましい。また、液温は20~80°Cであるのが好ましく、30~60°Cであるのがより好ましい。

## 【0042】

塩酸または硝酸を主体とする水溶液は、濃度0. 1~10質量%の塩酸または硝酸の水溶液に、硝酸アルミニウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウム等の硝酸イオンを有する硝酸化合物または塩化アルミニウム、塩化ナトリウム、塩化アンモニウム等の塩酸イオンを有する塩酸化合物の少なくとも一つを1g/しからん主体とする水溶液には、鉄、銅、マンガン、ニッケル、チタン、マグネシウム、シリカ等のアルミニウム合金中に含まれる金属が溶解していてよい。好ましくは、塩酸または硝酸の濃度0. 3~2質量%の水溶液にアルミニウムイオンが0. 3~5質量%となるように、塩化アルミニウム、硝酸アルミニウム等を添加した液を用いることが好ましい。

ここで、「主体とする」とは、水溶液中に主体となる成分が、成分全体に対して、30質量%以上、好ましくは50質量%以上含まれていることをいう。以下、他の成分においても同様である。

## 【0043】

更に、Cuと錯体を形成しうる化合物を添加して使用することによりCuを多く含有するアルミニウム板に対しても均一な砂目立てが可能になる。Cuと錯体を形成しうる化合物としては、例えば、アンモニア；メチルアミン、エチルアミン、ジメチルアミン、ジエチルアミン、トリメチルアミン、シクロヘキシリアミン、トリエタノールアミン、トリイソプロパノールアミン、EDTA（エチレンジアミン四酢酸）等のアンモニアの水素原子を炭化水素基（脂肪族、芳香族等）等で置換して得られるアミン類；炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素カリウム等の金属炭酸塩類が挙げられる。また、硝酸アンモニウム、塩化アンモニウム、硫酸アンモニウム、リン酸アンモニウム、炭酸アンモニウム等のアンモニウム塩も挙げられる。

温度は10～60℃が好ましく、20～50℃がより好ましい。

## 【0044】

電気化学的粗面化処理に用いられる交流電源波は、特に限定されず、サイン波、矩形波、台形波、三角波等が用いられるが、矩形波または台形波が好ましく、台形波が特に好ましい。台形波とは、図2に示したものをいう。この台形波において電流がゼロからピークに達するまでの時間（TP）は0.3～3msecであるのが好ましい。0.3msec未満であると、アルミニウム板の進行方向と垂直に発生するチャタマークという処理ムラが発生しやすい。TPが3msecを超えると、特に硝酸電解液を用いる場合、電解処理で自然発生的に増加するアンモニウムイオン等に代表される電解液中の微量成分の影響を受けやすくなり、均一な砂目立てが行われにくくなる。その結果、平版印刷版としたときの耐汚れ性が低下する傾向にある。

## 【0045】

台形波交流のduty比は1：2～2：1のものが使用可能であるが、特開平5-195300号公報に記載されているように、アルミニウムにコンダクタロールを用いない間接給電方式においてはduty比が1：1のものが好ましい。

台形波交流の周波数は0.1～120Hzのものを用いることが可能であるが、50～70Hzが設備上好ましい。50Hzよりも低いと、主極のカーボン電

極が溶解しやすくなり、また、70Hzよりも高いと、電源回路上のインダクタ  
ンス成分の影響を受けやすくなり、電源コストが高くなる。

## 【0046】

電解槽には1個以上の交流電源を接続することができる。主極に対向するアル  
ミニウム板に加わる交流の陽極と陰極との電流比をコントロールし、均一な砂目  
立てを行うことと、主極のカーボンを溶解することとを目的として、図3に示し  
たように、補助陽極を設置し、交流電流の一部を分流させることが好ましい。図  
3において、11はアルミニウム板であり、12はラジアルドラムローラであり  
、13aおよび13bは主極であり、14は電解処理液であり、15は電解液供  
給口であり、16はスリットであり、17は電解液通路であり、18は補助陽極  
であり、19aおよび19bはサイリスタであり、20は交流電源であり、40  
は主電解槽であり、50は補助陽極槽である。整流素子またはスイッチング素子  
を介して電流値の一部を二つの主電極とは別の槽に設けた補助陽極に直流電流と  
して分流させることにより、主極に対向するアルミニウム板上で作用するアノー  
ド反応にあずかる電流値と、カソード反応にあずかる電流値との比を制御するこ  
とができる。主極に対向するアルミニウム板上で、陽極反応と陰極反応とにあず  
かる電気量の比（陰極時電気量／陽極時電気量）は、0.3～0.95であるの  
が好ましい。

## 【0047】

電解槽は、縦型、フラット型、ラジアル型等の公知の表面処理に用いる電解槽  
が使用可能であるが、特開平5-195300号公報に記載されているようなラ  
ジアル型電解槽が特に好ましい。電解槽内を通過する電解液は、アルミニウムウ  
エブの進行方向に対してパラレルであってもカウンターであってもよい。

## 【0048】

## (硝酸電解)

硝酸を主体とする電解液を用いた電気化学的粗面化処理により、平均開口径0  
.5～5μmのピットを形成することができる。ただし、電気量を比較的多くし  
たときは、電解反応が集中し、5μmを超えるマクロピットも生成する。

このような砂目を得るために、電解反応が終了した時点でのアルミニウム板

のアノード反応にあずかる電気量の総和が、 $1 \sim 1000 \text{ C/dm}^2$  であるのが好ましく、 $50 \sim 400 \text{ C/dm}^2$  であるのがより好ましい。この際の電流密度は $5 \sim 100 \text{ A/dm}^2$  であるのが好ましい。

また、例えば、 $15 \sim 35$  質量%の高濃度の硝酸電解液を用いて $30 \sim 60^\circ\text{C}$  で電解を行ったり、 $0.7 \sim 2$  質量%の硝酸電解液を用いて $80^\circ\text{C}$  以上の高温で電解を行ったりすることで、平均開口径 $0.2 \mu\text{m}$  以下の小波構造を形成させることもできる。

## 【0049】

## (塩酸電解)

塩酸を主体とする電解液での電気化学的粗面化処理では、アノード反応にあずかる電気量の総和を調整することにより、何通りかの凹凸形状を形成できる。

まず、上記電気量の総和が少ない領域においては、塩酸はそれ自身のアルミニウム溶解力が強いため、わずかな電解を加えるだけで表面に微細な凹凸を形成させることが可能である。この微細な凹凸は、平均開口径が $0.01 \sim 0.2 \mu\text{m}$  であり、アルミニウム板の表面の全面に均一に生成する。このような砂目を得るために電解反応が終了した時点でのアルミニウム板のアノード反応にあずかる電気量の総和が、 $1 \sim 100 \text{ C/dm}^2$  であるのが好ましく、 $20 \sim 70 \text{ C/dm}^2$  であるのがより好ましい。この最の電流密度は、 $10 \sim 50 \text{ A/dm}^2$  であるのが好ましい。

## 【0050】

また、上記電気量の総和が大きい領域においては、アノード反応にあずかる電気量の総和を $100 \sim 2000 \text{ C/dm}^2$  とすることでクレーター状の大きなうねりを同時に形成することも可能である。特に上記電気量の総和を $300 \sim 2000 \text{ C/dm}^2$  にすることで大きなうねりをアルミニウム板の表面のほぼ全面に形成できる。この場合は平均開口径 $10 \sim 30 \mu\text{m}$  のクレーター状のうねりに重畠して平均開口径 $0.01 \sim 0.4 \mu\text{m}$  の微細な凹凸が全面に生成する。したがって、この場合、平均開口径 $0.5 \sim 5 \mu\text{m}$  の中波構造を重畠させられないが、表面積比 $\Delta S^{50(50)}$  および $\Delta S^{50(2-50)}$  を大きくできる。

## 【0051】

## &lt;アルカリエッティング処理&gt;

アルカリエッティング処理は、上記アルミニウム板をアルカリ溶液に接触させることにより、表層を溶解する処理である。

## 【0052】

電解粗面化処理より前に行われるアルカリエッティング処理は、機械的粗面化処理を行っていない場合には、前記アルミニウム板（圧延アルミ）の表面の圧延油、汚れ、自然酸化皮膜等を除去することを目的として、また、既に機械的粗面化処理を行っている場合には、機械的粗面化処理によって生成した凹凸のエッジ部分を溶解させ、急峻な凹凸を滑らかなうねりを持つ表面に変えることを目的として行われる。

## 【0053】

アルカリエッティング処理の前に機械的粗面化処理を行わない場合、エッティング量は、 $0.1 \sim 10 \text{ g/m}^2$  であるのが好ましく、 $1 \sim 5 \text{ g/m}^2$  であるのがより好ましい。エッティング量が $0.1 \text{ g/m}^2$  未満であると、表面の圧延油、汚れ、自然酸化皮膜等が残存する場合があるため、後段の電解粗面化処理において均一なピット生成ができずムラが発生してしまう場合がある。一方、エッティング量が $1 \sim 10 \text{ g/m}^2$  であると、表面の圧延油、汚れ、自然酸化皮膜等の除去が十分に行われる。上記範囲を超えるエッティング量とするのは、経済的に不利となる。

## 【0054】

アルカリエッティング処理の前に機械的粗面化処理を行う場合、エッティング量は、 $3 \sim 20 \text{ g/m}^2$  であるのが好ましく、 $5 \sim 15 \text{ g/m}^2$  であるのがより好ましい。エッティング量が $3 \text{ g/m}^2$  未満であると、機械的粗面化処理等によって形成された凹凸を平滑化できない場合があり、後段の電解処理において均一なピット形成ができない場合がある。また、印刷時に汚れが劣化する場合がある。一方、エッティング量が $20 \text{ g/m}^2$  を超えると、凹凸構造が消滅してしまう場合がある。

## 【0055】

電解粗面化処理の直後に行うアルカリエッティング処理は、酸性電解液中で生成

したスマットを溶解させることと、電解粗面化処理により形成されたピットのエッジ部分を溶解させることを目的として行われる。

電解粗面化処理で形成されるピットは電解液の種類によって異なるためにその最適なエッティング量も異なるが、電解粗面化処理後に行うアルカリエッティング処理のエッティング量は、0.1～5 g/m<sup>2</sup> であるのが好ましい。硝酸電解液を用いた場合、塩酸電解液を用いた場合よりもエッティング量は多めに設定する必要がある。

電解粗面化処理が複数回行われる場合には、それぞれの処理後に、必要に応じてアルカリエッティング処理を行うことができる。

#### 【0056】

アルカリ溶液に用いられるアルカリとしては、例えば、カセイアルカリ、アルカリ金属塩が挙げられる。具体的には、カセイアルカリとしては、例えば、カセイソーダ、カセイカリが挙げられる。また、アルカリ金属塩としては、例えば、メタケイ酸ソーダ、ケイ酸ソーダ、メタケイ酸カリ、ケイ酸カリ等のアルカリ金属ケイ酸塩；炭酸ソーダ、炭酸カリ等のアルカリ金属炭酸塩；アルミニ酸ソーダ、アルミニ酸カリ等のアルカリ金属アルミニ酸塩；グルコン酸ソーダ、グルコン酸カリ等のアルカリ金属アルドン酸塩；第二リン酸ソーダ、第二リン酸カリ、第三リン酸ソーダ、第三リン酸カリ等のアルカリ金属リン酸水素塩が挙げられる。中でも、エッティング速度が速い点および安価である点から、カセイアルカリの溶液、および、カセイアルカリとアルカリ金属アルミニ酸塩との両者を含有する溶液が好ましい。特に、カセイソーダの水溶液が好ましい。

#### 【0057】

アルカリ溶液の濃度は、エッティング量に応じて決定することができるが、1～50質量%であるのが好ましく、10～35質量%であるのがより好ましい。アルカリ溶液中にアルミニウムイオンが溶解している場合には、アルミニウムイオンの濃度は、0.01～10質量%であるのが好ましく、3～8質量%であるのがより好ましい。アルカリ溶液の温度は20～90℃であるのが好ましい。処理時間は1～120秒であるのが好ましい。

#### 【0058】

アルミニウム板をアルカリ溶液に接触させる方法としては、例えば、アルミニウム板をアルカリ溶液を入れた槽の中を通過させる方法、アルミニウム板をアルカリ溶液を入れた槽の中に浸せきさせる方法、アルカリ溶液をアルミニウム板の表面に噴きかける方法が挙げられる。

## 【0059】

## &lt;デスマット処理&gt;

電解粗面化処理またはアルカリエッティング処理を行った後、表面に残留する汚れ（スマット）を除去するために酸洗い（デスマット処理）が行われる。用いられる酸としては、例えば、硝酸、硫酸、リン酸、クロム酸、フッ化水素酸、ホウフッ化水素酸が挙げられる。

上記デスマット処理は、例えば、上記アルミニウム板を塩酸、硝酸、硫酸等の濃度0.5～30質量%の酸性溶液（アルミニウムイオン0.01～5質量%を含有する。）に接触させることにより行う。アルミニウム板を酸性溶液に接触させる方法としては、例えば、アルミニウム板を酸性溶液を入れた槽の中を通過させる方法、アルミニウム板を酸性溶液を入れた槽の中に浸せきさせる方法、酸性溶液をアルミニウム板の表面に噴きかける方法が挙げられる。

デスマット処理においては、酸性溶液として、上述した電解粗面化処理において排出される硝酸を主体とする水溶液もしくは塩酸を主体とする水溶液の廃液、または、後述する陽極酸化処理において排出される硫酸を主体とする水溶液の廃液を用いることができる。

デスマット処理の液温は、25～90℃であるのが好ましい。また、処理時間は、1～180秒であるのが好ましい。デスマット処理に用いられる酸性溶液には、アルミニウムおよびアルミニウム合金成分が溶け込んでいてもよい。

## 【0060】

## &lt;陽極酸化処理&gt;

以上のように処理されたアルミニウム板には、更に、陽極酸化処理が施されるのが好ましい。陽極酸化処理はこの分野で従来行われている方法で行うことができる。この場合、例えば、硫酸濃度50～300g/Lで、アルミニウム濃度5質量%以下の溶液中で、アルミニウム板を陽極として通電して陽極酸化皮膜を形

成させることができる。陽極酸化処理に用いられる溶液としては、硫酸、リン酸、クロム酸、シウ酸、スルファミン酸、ベンゼンスルホン酸、アミドスルホン酸等を単独でまたは2種以上を組み合わせて用いることができる。

## 【0061】

この際、少なくともアルミニウム板、電極、水道水、地下水等に通常含まれる成分が電解液中に含まれていても構わない。更には、第2、第3の成分が添加されても構わない。ここでいう第2、第3の成分としては、例えば、Na、K、Mg、Li、Ca、Ti、Al、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn等の金属のイオン；アンモニウムイオン等の陽イオン；硝酸イオン、炭酸イオン、塩化物イオン、リン酸イオン、フッ化物イオン、亜硫酸イオン、チタン酸イオン、ケイ酸イオン、ホウ酸イオン等の陰イオンが挙げられ、0～10000 ppm程度の濃度で含まれていてもよい。

## 【0062】

陽極酸化処理の条件は、使用される電解液によって種々変化するので一概に決定され得ないが、一般的には電解液濃度1～80質量%、液温5～70℃、電流密度0.5～60A/dm<sup>2</sup>、電圧1～100V、電解時間15秒～50分であるのが適当であり、所望の陽極酸化皮膜量となるように調整される。

## 【0063】

また、特開昭54-81133号、特開昭57-47894号、特開昭57-51289号、特開昭57-51290号、特開昭57-54300号、特開昭57-136596号、特開昭58-107498号、特開昭60-20025号、特開昭62-136596号、特開昭63-176494号、特開平4-176897号、特開平4-280997号、特開平6-207299号、特開平5-24377号、特開平5-32083号、特開平5-125597号、特開平5-195291号の各公報等に記載されている方法を使用することもできる。

## 【0064】

中でも、特開昭54-12853号公報および特開昭48-45303号公報に記載されているように、電解液として硫酸溶液を用いるのが好ましい。電解液

中の硫酸濃度は、10～300g/L(1～30質量%)であるのが好ましく、また、アルミニウムイオン濃度は、1～25g/L(0.1～2.5質量%)であるのが好ましく、2～10g/L(0.2～1質量%)であるのがより好ましい。このような電解液は、例えば、硫酸濃度が50～200g/Lである希硫酸に硫酸アルミニウム等を添加することにより調製することができる。

## 【0065】

硫酸を含有する電解液中で陽極酸化処理を行う場合には、アルミニウム板と対極との間に直流を印加してもよく、交流を印加してもよい。

アルミニウム板に直流を印加する場合においては、電流密度は、1～60A/dm<sup>2</sup>であるのが好ましく、5～40A/dm<sup>2</sup>であるのがより好ましい。

連続的に陽極酸化処理を行う場合には、アルミニウム板の一部に電流が集中していわゆる「焼け」が生じないように、陽極酸化処理の開始当初は、5～10A/m<sup>2</sup>の低電流密度で電流を流し、陽極酸化処理が進行するにつれ、30～50A/dm<sup>2</sup>またはそれ以上に電流密度を増加させるのが好ましい。

連続的に陽極酸化処理を行う場合には、アルミニウム板に、電解液を介して給電する液給電方式により行うのが好ましい。

このような条件で陽極酸化処理を行うことによりポア（マイクロポア）と呼ばれる孔を多数有する多孔質皮膜が得られるが、通常、その平均ポア径は5～50nm程度であり、平均ポア密度は300～800個/μm<sup>2</sup>程度である。

## 【0066】

陽極酸化皮膜の量は1～5g/m<sup>2</sup>であるのが好ましい。1g/m<sup>2</sup>未満であると版に傷が入りやすくなり、一方、5g/m<sup>2</sup>を超えると製造に多大な電力が必要となり、経済的に不利となる。陽極酸化皮膜の量は、1.5～4g/m<sup>2</sup>であるのがより好ましい。また、アルミニウム板の中央部と縁部近傍との間の陽極酸化皮膜量の差が1g/m<sup>2</sup>以下になるように行うのが好ましい。

## 【0067】

陽極酸化処理に用いられる電解装置としては、特開昭48-26638号、特開昭47-18739号、特公昭58-24517号の各公報等に記載されているものを用いることができる。

中でも、図4に示す装置が好適に用いられる。図4は、アルミニウム板の表面を陽極酸化処理する装置の一例を示す概略図である。陽極酸化処理装置410において、アルミニウム板416は、図4中矢印で示すように搬送される。電解液418が貯溜された給電槽412にてアルミニウム板416は給電電極420によって(+)に荷電される。そして、アルミニウム板416は、給電槽412においてローラ422によって上方に搬送され、ニップローラ424によって下方に方向変換された後、電解液426が貯溜された電解処理槽414に向けて搬送され、ローラ428によって水平方向に方向転換される。ついで、アルミニウム板416は、電解電極430によって(-)に荷電されることにより、その表面に陽極酸化皮膜が形成され、電解処理槽414を出たアルミニウム板416は後工程に搬送される。前記陽極酸化処理装置410において、ローラ422、ニップローラ424およびローラ428によって方向転換手段が構成され、アルミニウム板416は、給電槽412と電解処理槽414との槽間部において、前記ローラ422、424および428により、山型および逆U字型に搬送される。給電電極420と電解電極430とは、直流電源434に接続されている。

#### 【0068】

図4の陽極酸化処理装置410の特徴は、給電槽412と電解処理槽414とを1枚の槽壁432で仕切り、アルミニウム板416を槽間部において山型および逆U字型に搬送したことにある。これによって、槽間部におけるアルミニウム板416の長さを最短にすることができる。よって、陽極酸化処理装置410の全体長を短くできるので、設備費を低減することができる。また、アルミニウム板416を山型および逆U字型に搬送することによって、各槽412および414の槽壁にアルミニウム板416を通過させるための開口部を形成する必要がなくなる。よって、各槽412および414内の液面高さを必要レベルに維持するのに要する送液量を抑えることができるので、稼働費を低減することができる。

#### 【0069】

##### 〈封孔処理〉

本発明においては、必要に応じて陽極酸化皮膜に存在するマイクロポアを封じる封孔処理を行ってもよい。封孔処理は、沸騰水処理、熱水処理、蒸気処理、ケ

イ酸ソーダ処理、亜硝酸塩処理、酢酸アンモニウム処理等の公知の方法に従って行うことができる。例えば、特公昭56-12518号公報、特開平4-4194号公報、特願平4-33952号明細書（特開平5-202496号公報）、特願平4-33951号明細書（特開平5-179482号公報）等に記載されている装置および方法で封孔処理を行ってもよい。

## 【0070】

## &lt;親水化処理&gt;

陽極酸化処理後または封孔処理後、親水化処理を行ってもよい。親水化処理としては、例えば、米国特許第2,946,638号明細書に記載されているフッ化ジルコニウム酸カリウム処理、米国特許第3,201,247号明細書に記載されているホスホモリブデート処理、英國特許第1,108,559号に記載されているアルキルチタネート処理、獨国特許第1,091,433号明細書に記載されているポリアクリル酸処理、獨国特許第1,134,093号明細書および英國特許第1,230,447号明細書に記載されているポリビニルホスホン酸処理、特公昭44-6409号公報に記載されているホスホン酸処理、米国特許第3,307,951号明細書に記載されているフィチン酸処理、特開昭58-16893号公報および特開昭58-18291号公報に記載されている親油性有機高分子化合物と2価の金属との塩による処理、米国特許第3,860,426号明細書に記載されているように、水溶性金属塩（例えば、酢酸亜鉛）を含む親水性セルロース（例えば、カルボキシメチルセルロース）の下塗層を設ける処理、特開昭59-101651号公報に記載されているスルホ基を有する水溶性重合体を下塗りする処理が挙げられる。

## 【0071】

また、特開昭62-019494号公報に記載されているリン酸塩、特開昭62-033692号公報に記載されている水溶性エポキシ化合物、特開昭62-097892号公報に記載されているリン酸変性デンプン、特開昭63-056498号公報に記載されているジアミン化合物、特開昭63-130391号公報に記載されているアミノ酸の無機または有機酸、特開昭63-145092号公報に記載されているカルボキシ基またはヒドロキシ基を含む有機ホスホン酸、

特開昭63-165183号公報に記載されているアミノ基とホスホン酸基を有する化合物、特開平2-316290号公報に記載されている特定のカルボン酸誘導体、特開平3-215095号公報に記載されているリン酸エステル、特開平3-261592号公報に記載されている1個のアミノ基とリンの酸素酸基1個を持つ化合物、特開平3-215095号公報に記載されているリン酸エステル、特開平5-246171号公報に記載されているフェニルホスホン酸等の脂肪族または芳香族ホスホン酸、特開平1-307745号公報に記載されているチオサリチル酸のようなS原子を含む化合物、特開平4-282637号公報に記載されているリンの酸素酸のグループを持つ化合物等を用いた下塗りによる処理も挙げられる。

更に、特開昭60-64352号公報に記載されている酸性染料による着色を行ふこともできる。

### 【0072】

また、ケイ酸ソーダ、ケイ酸カリ等のアルカリ金属ケイ酸塩の水溶液に浸せきさせる方法、親水性ビニルポリマーまたは親水性化合物を塗布して親水性の下塗層を形成させる方法等により、親水化処理を行うのが好ましい。

### 【0073】

ケイ酸ソーダ、ケイ酸カリ等のアルカリ金属ケイ酸塩の水溶液による親水化処理は、米国特許第2,714,066号明細書および米国特許第3,181,461号明細書に記載されている方法および手順に従って行うことができる。

アルカリ金属ケイ酸塩としては、例えば、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸カリウム、ケイ酸リチウムが挙げられる。アルカリ金属ケイ酸塩の水溶液は、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム等を適当量含有してもよい。

また、アルカリ金属ケイ酸塩の水溶液は、アルカリ土類金属塩または4族（第IVA族）金属塩を含有してもよい。アルカリ土類金属塩としては、例えば、硝酸カルシウム、硝酸ストロンチウム、硝酸マグネシウム、硝酸バリウム等の硝酸カルシウム、塩酸塩；リン酸塩；酢酸塩；シウ酸塩；ホウ酸塩が挙げられる。4族（第IVA族）金属塩としては、例えば、四塩化チタン、三塩化チタン、フッ化チタンカリウム、シウ酸チタンカリウム、硫酸チタン、四ヨウ化チタン、

塩化酸化ジルコニウム、二酸化ジルコニウム、オキシ塩化ジルコニウム、四塩化ジルコニウムが挙げられる。これらのアルカリ土類金属塩および4族（第ⅣA族）金属塩は、単独でまたは2種以上組み合わせて用いられる。

## 【0074】

アルカリ金属ケイ酸塩処理によって吸着するSi量は蛍光X線分析装置により測定することができ、その吸着量は約1.0~15.0mg/m<sup>2</sup>であるのが好ましい。

このアルカリ金属ケイ酸塩処理により、平版印刷版用支持体の表面のアルカリ現像液に対する耐溶解性向上の効果が得られ、アルミニウム成分の現像液中への溶出が抑制されて、現像液の疲労に起因する現像カスの発生を低減することができる。

本発明の平版印刷版用支持体は、上述したように、 $\Delta S^{50}$ が大きく、画像記録層と支持体との接着性に優れるので、アルカリ金属ケイ酸塩処理を行った場合であっても、十分な耐刷性が得られる。したがって、アルカリ金属ケイ酸塩処理を行っても、耐刷性の低下のおそれなく、耐汚れ性の向上および現像カス発生の低減という利点のみを享受することができる。

## 【0075】

また、親水性の下塗層の形成による親水化処理は、特開昭59-101651号公報および特開昭60-149491号公報に記載されている条件および手順に従って行うこともできる。

この方法に用いられる親水性ビニルポリマーとしては、例えば、ポリビニルスルホン酸、スルホ基を有するp-アスチレンスルホン酸等のスルホ基含有ビニル重合性化合物と（メタ）アクリル酸アルキルエステル等の通常のビニル重合性化合物との共重合体が挙げられる。また、この方法に用いられる親水性化合物としては、例えば、-NH<sub>2</sub>基、-COOH基およびスルホ基からなる群から選ばれる少なくとも一つを有する化合物が挙げられる。

## 【0076】

## &lt;水洗処理&gt;

上述した各処理の工程終了後には水洗を行うのが好ましい。水洗には、純水、

井水、水道水等を用いることができる。処理液の次工程への持ち込みを防ぐためにニップ装置を用いてもよい。

## 【0077】

## &lt;アルミニウム板(圧延アルミ)&gt;

本発明の平版印刷版用支持体を得るために公知のアルミニウム板を用いることができる。本発明に用いられるアルミニウム板は、寸度的に安定なアルミニウムを主成分とする金属であり、アルミニウムまたはアルミニウム合金からなる。純アルミニウム板のほか、アルミニウムを主成分とし微量の異元素を含む合金板を用いることもできる。

## 【0078】

本明細書においては、上述したアルミニウムまたはアルミニウム合金からなる各種の基板をアルミニウム板と総称して用いる。前記アルミニウム合金に含まれてもよい異元素には、ケイ素、鉄、マンガン、銅、マグネシウム、クロム、亜鉛、ビスマス、ニッケル、チタン等があり、合金中の異元素の含有量は10質量%以下である。

## 【0079】

このように本発明に用いられるアルミニウム板は、その組成が特定されるものではなく、例えば、アルミニウムハンドブック第4版(1990年、軽金属協会発行)に記載されている従来公知の素材、例えば、JIS A1050、JIS A1100、JIS A1070、Mnを含むJIS A3004、国際登録合金3103A等のA1-Mn系アルミニウム板を適宜利用することができる。また、引張強度を増す目的で、これらのアルミニウム合金に0.1質量%以上のマグネシウムを添加したA1-Mg系合金、A1-Mn-Mg系合金(JIS A3005)を用いることもできる。更に、ZrやSiを含むA1-Zr系合金やA1-Si系合金を用いることもできる。更に、A1-Mg-Si系合金を用いることもできる。

また、これらのA1材のスクラップを用いてもよい。

## 【0080】

JIS1050材に関しては、本願出願人によって提案された技術が、特開昭

59-153861号、特開昭61-51395号、特開昭62-146694号、特開昭60-215725号、特開昭60-215726号、特開昭60-215727号、特開昭60-216728号、特開昭61-272367号、特開昭58-11759号、特開昭58-42493号、特開昭58-221254号、特開昭62-148295号、特開平4-254545号、特開平4-165041号、特公平3-68939号、特開平3-234594号、特公平1-47545号および特開昭62-140894号の各公報に記載されている。また、特公平1-35910号公報、特公昭55-28874号公報等に記載された技術も知られている。

## 【0081】

JIS1070材に関しては、本願出願人によって提案された技術が、特開平7-81264号、特開平7-305133号、特開平8-49034号、特開平8-73974号、特開平8-108659号および特開平8-92679号の各公報に記載されている。

## 【0082】

A1-Mg系合金に関しては、本願出願人によって提案された技術が、特公昭62-5080号、特公昭63-60823号、特公平3-61753号、特開昭60-203496号、特開昭60-203497号、特公平3-11635号、特開昭61-274993号、特開昭62-23794号、特開昭63-4号、特開昭63-47348号、特開昭63-47349号、特開昭67347号、特開昭63-47348号、特開昭63-47349号、特開昭64-1293号、特開昭63-135294号、特開昭63-87288号、特公平4-73392号、特公平7-100844号、特開昭62-149856号、特公平4-73394号、特開昭62-181191号、特公平5-765号、特開昭63-30294号および特公平6-37116号の各公報に記載されている。また、特開平2-215599号公報、特開昭61-201747号公報等にも記載されている。

## 【0083】

A1-Mn系合金に関しては、本願出願人によって提案された技術が、特開昭60-230951号、特開平1-306288号および特開平2-29318

9号の各公報に記載されている。また、特公昭54-42284号、特公平4-19290号、特公平4-19291号、特公平4-19292号、特開昭61-35995号、特開昭64-51992号、特開平4-226394号の各公報、米国特許第5,009,722号明細書、同第5,028,276号明細書等にも記載されている。

## 【0084】

Al-Mn-Mg系合金に関しては、本願出願人によって提案された技術が、特開昭62-86143号公報および特開平3-222796号公報に記載されている。また、特公昭63-60824号、特開昭60-63346号、特開昭60-63347号、特開平1-293350号の各公報、欧州特許第223,737号、米国特許第4,818,300号、英国特許第1,222,777号の各明細書等にも記載されている。

## 【0085】

Al-Zr系合金に関しては、本願出願人によって提案された技術が、特公昭63-15978号公報および特開昭61-51395号公報に記載されている。また、特開昭63-143234号、特開昭63-143235号の各公報等にも記載されている。

## 【0086】

Al-Mg-Si系合金に関しては、英国特許第1,421,710号明細書等に記載されている。

## 【0087】

アルミニウム合金を板材とするには、例えば、下記の方法を採用することができる。まず、所定の合金成分含有量に調整したアルミニウム合金溶湯に、常法に従い、清浄化処理を行い、鋳造する。清浄化処理には、溶湯中の水素等の不要ガスを除去するために、フラックス処理、アルゴンガス、塩素ガス等を用いる脱ガス処理、セラミックチューブフィルタ、セラミックフォームフィルタ等のいわゆるリジッドメディアフィルタや、アルミナフレーク、アルミナボール等をろ材とするフィルタや、グラスクロスフィルタ等を用いるフィルタリング処理、あるいは、脱ガス処理とフィルタリング処理を組み合わせた処理が行われる。

## 【0088】

これらの清浄化処理は、溶湯中の非金属介在物、酸化物等の異物による欠陥や、溶湯に溶け込んだガスによる欠陥を防ぐために実施されることが好ましい。溶湯のフィルタリングに関しては、特開平6-57432号、特開平3-162530号、特開平5-140659号、特開平4-231425号、特開平4-276031号、特開平5-311261号、特開平6-136466号の各公報等に記載されている。また、溶湯の脱ガスに関しては、特開平5-51659号公報、実開平5-49148号公報等に記載されている。本願出願人も、特開平7-40017号公報において、溶湯の脱ガスに関する技術を提案している。

## 【0089】

ついで、上述したように清浄化処理を施された溶湯を用いて鋳造を行う。鋳造方法に関しては、DC鋳造法に代表される固体鋳型を用いる方法と、連続鋳造法に代表される駆動鋳型を用いる方法がある。

DC鋳造においては、冷却速度が0.5~30°C/秒の範囲で凝固する。1°C未満であると粗大な金属間化合物が多数形成されることがある。DC鋳造を行った場合、板厚300~800mmの鋳塊を製造することができる。その鋳塊を、常法に従い、必要に応じて面削を行い、通常、表層の1~30mm、好ましくは1~10mmを切削する。その前後において、必要に応じて、均熱化処理を行う。均熱化処理を行う場合、金属間化合物が粗大化しないように、450~620°Cで1~48時間の熱処理を行う。熱処理が1時間より短い場合には、均熱化処理の効果が不十分となることがある。

## 【0090】

その後、熱間圧延、冷間圧延を行ってアルミニウム板の圧延板とする。熱間圧延の開始温度は350~500°Cが適当である。熱間圧延の前もしくは後、またはその途中において、中間焼鈍処理を行ってもよい。中間焼鈍処理の条件は、バッチ式焼鈍炉を用いて280~600°Cで2~20時間、好ましくは350~500°Cで2~10時間加熱するか、連続焼鈍炉を用いて400~600°Cで6分以下、好ましくは450~550°Cで2分以下加熱するかである。連続焼鈍炉を用いて10~200°C/秒の昇温速度で加熱して、結晶組織を細かくすることも

できる。

## 【0091】

以上の工程によって、所定の厚さ、例えば、0.1～0.5 mmに仕上げられたアルミニウム板は、更にローラレベラ、テンションレベラ等の矯正装置によって平面性を改善してもよい。平面性の改善は、アルミニウム板をシート状にカットした後に行ってもよいが、生産性を向上させるためには、連續したコイルの状態で行なうことが好ましい。また、所定の板幅に加工するため、スリッターラインを通してよい。また、アルミニウム板同士の摩擦による傷の発生を防止するため、アルミニウム板の表面に薄い油膜を設けてよい。油膜には、必要に応じて、揮発性のものや、不揮発性のものが適宜用いられる。

## 【0092】

一方、連續铸造法としては、双ロール法（ハンター法）、3C法に代表される冷却ロールを用いる方法、双ベルト法（ハズレー法）、アルスイスキャスターI型に代表される冷却ベルトや冷却ブロックを用いる方法が、工業的に行なわれていて、連續铸造法を用いる場合には、冷却速度が100～1000°C/秒の範囲である。連續铸造法を用いる場合には、冷却速度がDC铸造法に比べて冷却速度が速いため、アルミマトリックスに対する合金成分固溶度を高くすることができるという特徴を有する。連續铸造法に関しては、本願出願人によって提案された技術が、特開平3-79798号、特開平5-201166号、特開平5-156414号、特開平6-262203号、特開平6-122949号、特開平6-210406号、特開平6-26308号の各公報等に記載されている。

## 【0093】

連續铸造を行った場合において、例えば、ハンター法等の冷却ロールを用いる方法を用いると、板厚1～10 mmの铸造板を直接、連續铸造することができ、熱間圧延の工程を省略することができるというメリットが得られる。また、ハズレー法等の冷却ベルトを用いる方法を用いると、板厚10～50 mmの铸造板を铸造することができ、一般的に、铸造直後に熱間圧延ロールを配置し連續的に圧延することで、板厚1～10 mmの連續铸造圧延板が得られる。

## 【0094】

これらの連続鋳造圧延板は、DC鋳造について説明したのと同様に、冷間圧延、中間焼純、平面性の改善、スリット等の工程を経て、所定の厚さ、例えば、0.1～0.5mmの板厚に仕上げられる。連続鋳造法を用いた場合の中間焼純条件および冷間圧延条件については、本願出願人によって提案された技術が、特開平6-220593号、特開平6-210308号、特開平7-54111号、特開平8-92709号の各公報等に記載されている。

## 【0095】

このようにして製造されるアルミニウム板には、以下に述べる種々の特性が望まれる。

アルミニウム板の強度は、平版印刷版用支持体として必要な腰の強さを得るために、0.2%耐力が140MPa以上であるのが好ましい。また、バーニング処理を行った場合にもある程度の腰の強さを得るために、270°Cで3～10分間加熱処理した後の0.2%耐力が80MPa以上であるのが好ましく、100MPa以上であるのがより好ましい。特に、アルミニウム板に腰の強さを求める場合は、MgやMnを添加したアルミニウム材料を採用することができるが、腰を強くすると印刷機の版胴へのフィットしやすさが劣ってくるため、用途に応じて、材質および微量成分の添加量が適宜選択される。これらに関して、本願出願人によって提案された技術が、特開平7-126820号公報、特開昭62-140894号公報等に記載されている。

## 【0096】

アルミニウム板の結晶組織は、化学的粗面化処理や電気化学的粗面化処理を行った場合、アルミニウム板の表面の結晶組織が面質不良の発生の原因となることがあるので、表面においてあまり粗大でないことが好ましい。アルミニウム板の表面の結晶組織は、幅が200μm以下であるのが好ましく、100μm以下であるのがより好ましく、50μm以下であるのが更に好ましく、また、結晶組織の長さが5000μm以下であるのが好ましく、1000μm以下であるのがより好ましく、500μm以下であるのが更に好ましい。これらに関して、本願出願人によって提案された技術が、特開平6-218495号、特開平7-39906号、特開平7-124609号の各公報等に記載されている。

## 【0097】

アルミニウム板の合金成分分布は、化学的粗面化処理や電気化学的粗面化処理を行った場合、アルミニウム板の表面の合金成分の不均一な分布に起因して面質不良が発生するがあるので、表面においてあまり不均一でないことが好ましい。これらに関して、本願出願人によって提案された技術が、特開平6-48058号、特開平5-301478号、特開平7-132689号の各公報等に記載されている。

## 【0098】

アルミニウム板の金属間化合物は、その金属間化合物のサイズや密度が、化学的粗面化処理や電気化学的粗面化処理に影響を与える場合がある。これらに関して、本願出願人によって提案された技術が、特開平7-138687号、特開平4-254545号の各公報等に記載されている。

## 【0099】

本発明においては、上記に示されるようなアルミニウム板をその最終圧延工程において、積層圧延、転写等により凹凸を付けて用いることもできる。

## 【0100】

本発明に用いられるアルミニウム板は、連続した帯状のシート材または板材である。即ち、アルミニウムウェブであってもよく、製品として出荷される平版印刷版原版に対応する大きさ等に裁断された枚葉状シートであってもよい。

アルミニウム板の表面のキズは平版印刷版用支持体に加工した場合に欠陥となる可能性があるため、平版印刷版用支持体とする表面処理工程の前の段階でのキズの発生は可能な限り抑制する必要がある。そのためには安定した形態で運搬時に傷付きにくい荷姿であることが好ましい。

アルミニウムウェブの場合、アルミニウムの荷姿としては、例えば、鉄製パレットにハードボードとフェルトとを敷き、製品両端に段ボールドーナツ板を当て、ポリチューブで全体を包み、コイル内径部に木製ドーナツを挿入し、コイル外周部にフェルトを当て、帶鉄で絞め、その外周部に表示を行う。また、包装材としては、ポリエチレンフィルム、緩衝材としては、ニードルフェルト、ハードボードを用いることができる。この他にもいろいろな形態があるが、安定して、キ

ズも付かず運送等が可能であればこの方法に限るものではない。

## 【0101】

本発明に用いられるアルミニウム板の厚みは、0.1～0.6mm程度であり、0.15～0.4mmであるのが好ましく、0.2～0.3mmであるのがより好ましい。この厚みは、印刷機の大きさ、印刷版の大きさ、ユーザーの希望等により適宜変更することができる。

## 【0102】

## [平版印刷版原版]

つぎに、本発明の平版印刷版原版について説明する。本発明の平版印刷版原版は、本発明の平版印刷版用支持体上に画像記録層を設けてなる。

## 【0103】

## &lt;下塗層&gt;

本発明の平版印刷版原版においては、上記のようにして得られた本発明の平版印刷版用支持体上に、画像記録層を設ける前に、必要に応じて、例えば、ホウ酸亜鉛等の水溶性金属塩のような無機下塗層や、有機下塗層を設けてもよい。

## 【0104】

有機下塗層に用いられる有機化合物としては、例えば、カルボキシメチルセルロース；デキストリン；アラビアガム；スルホン酸基を側鎖に有する重合体および共重合体；ポリアクリル酸；2-アミノエチルホスホン酸等のアミノ基を有するホスホン酸類；置換基を有していてもよいフェニルホスホン酸、ナフチルホスホン酸、アルキルホスホン酸、グリセロホスホン酸、メチレンジホスホン酸、エチレンジホスホン酸等の有機ホスホン酸；置換基を有していてもよいフェニルリシン酸、ナフチルリシン酸、アルキルリシン酸、グリセロリシン酸等の有機リシン酸；置換基を有していてもよいフェニルホスフィン酸、ナフチルホスフィン酸、アルキルホスフィン酸、グリセロホスフィン酸等の有機ホスフィン酸；グリシン、 $\beta$ -アラニン等のアミノ酸類；トリエタノールアミンの塩酸塩等のヒドロキシ基を有するアミンの塩酸塩；黄色染料が挙げられる。これらは単独で用いてもよく、2種以上を混合して用いてもよい。

## 【0105】

有機下塗層は、水もしくはメタノール、エタノール、メチルエチルケトン等の有機溶媒、またはそれらの混合溶剤に、上記有機化合物を溶解させた溶液をアルミニウム板上に塗布し乾燥することにより設けられる。上記有機化合物を溶解させた溶液の濃度は、0.005～10質量%であるのが好ましい。塗布の方法は、特に限定されず、バーコーター塗布、回転塗布、スプレー塗布、カーテン塗布等のいずれの方法も用いることができる。

有機下塗層の乾燥後の被覆量は、2～200mg/m<sup>2</sup>であるのが好ましく、5～100mg/m<sup>2</sup>であるのがより好ましい。上記範囲であると、耐刷性がより良好になる。

#### 【0106】

##### ＜画像記録層＞

本発明の平版印刷版用支持体には、以下に例示する感光層、感熱層等の画像記録層を設けて本発明の平版印刷版原版とすることができる。画像記録層は、例えば、コンベンショナルポジタイプ、コンベンショナルネガタイプ、フォトポリマータイプ、サーマルポジタイプ、サーマルネガタイプ、機上現像可能な無処理タイプが好適に挙げられる。以下、これらの好適な画像記録層について説明する。

#### 【0107】

##### ＜コンベンショナルポジタイプ＞

コンベンショナルポジタイプの感光層に好適に用いられる感光性樹脂組成物としては、例えば、o-キノンジアジド化合物と水不溶性かつアルカリ可溶性の高分子化合物（以下、「アルカリ可溶性高分子化合物」という。）とを含有する組成物が挙げられる。

o-キノンジアジド化合物としては、例えば、1,2-ナフトキノン-2-ジアジド-5-スルホニルクロライドとフェノール・ホルムアルデヒド樹脂またはクレゾール・ホルムアルデヒド樹脂とのエステルや、米国特許第3,635,709号明細書に記載されている1,2-ナフトキノン-2-ジアジド-5-スルホニルクロライドとピロガロール・アセトン樹脂とのエステルが挙げられる。

アルカリ可溶性高分子化合物としては、例えば、フェノール・ホルムアルデヒド樹脂、クレゾール・ホルムアルデヒド樹脂、フェノール・クレゾール・ホルム

アルデヒド共縮合樹脂、ポリヒドロキシスチレン、N-(4-ヒドロキシフェニル)メタクリルアミドの共重合体、特開平7-36184号公報に記載されているカルボキシ基含有ポリマー、特開昭51-34711号公報に記載されているようなフェノール性ヒドロキシ基を含有するアクリル系樹脂、特開平2-866号に記載されているスルホンアミド基を有するアクリル系樹脂や、ウレタン系樹脂が挙げられる。

更に感光性樹脂組成物には、特開平7-92660号公報の[0024]～[0027]に記載されている感度調節剤、焼出剤、染料等の化合物や同公報の[0031]に記載されているような塗布性を良化するための界面活性剤を加えることが好ましい。

## 【0108】

## &lt;コンベンショナルネガタイプ&gt;

コンベンショナルネガタイプの感光層に好適に用いられる感光性樹脂組成物としては、ジアゾ樹脂とアルカリ可溶性または膨潤性の高分子化合物（以下、「結合剤」という。）とを含有する組成物が挙げられる。

ジアゾ樹脂としては、例えば、芳香族ジアゾニウム塩とホルムアルデヒド等の活性カルボニル基含有化合物との縮合物、p-ジアゾフェニルアミン類とホルムアルデヒドとの縮合物とヘキサフルオロリン酸塩またはテトラフルオロホウ酸塩との反応生成物である有機溶媒可溶性ジアゾ樹脂無機塩が挙げられる。特に、特開昭59-78340号公報に記載されている6量体以上を20モル%以上含んでいる高分子量ジアゾ化合物が好ましい。

好適な結合剤としては、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸またはマレイン酸を必須成分として含む共重合体、具体的には、特開昭50-118号公報に記載されているような2-ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、（メタ）アクリロニトリル、（メタ）アクリル酸等のモノマーの多元共重合体や、特開昭56-4144号公報に記載されているようなアルキルアクリレート、（メタ）アクリロニトリル、および、不飽和カルボン酸からなる多元共重合体が挙げられる。

更に感光性樹脂組成物には、特開平7-281425号公報の[0014]～

【0015】に記載されている焼出剤、染料、塗膜の柔軟性や耐摩耗性を付与するための可塑剤、現像促進剤等の化合物や、塗布性を良化するための界面活性剤を加えることが好ましい。

上述したコンベンショナルタイプのポジ型もしくはネガ型感光層の下塗層としては、特開2000-105462号公報に記載されている、酸基を有する構成成分とオニウム基を有する構成成分とを有する高分子化合物を含有する中間層を設けることが好ましい。

#### 【0109】

##### 〈フォトポリマータイプ〉

フォトポリマータイプの感光層に好適に用いられる光重合型感光性組成物（以下、「光重合性組成物」という。）は、付加重合可能なエチレン性不飽和結合含有化合物（以下、単に「エチレン性不飽和結合含有化合物」という。）と、光重合開始剤と、高分子結合剤とを必須成分として含有し、必要に応じて、着色剤、可塑剤、熱重合禁止剤等の種々の化合物を含有する。

光重合性組成物に含有されるエチレン性不飽和結合含有化合物は、光重合性組成物が活性光線の照射を受けた場合に、光重合開始剤の作用により付加重合し、架橋し硬化するようなエチレン性不飽和結合を有する化合物である。エチレン性不飽和結合含有化合物は、末端エチレン性不飽和結合を少なくとも1個、好ましくは2個以上有する化合物の中から任意に選択することができ、例えば、モノマー、プレポリマー（即ち、2量体、3量体およびオリゴマー）、これらの混合物、これらの共重合体等の化学的形態を有する。モノマーの例としては、不飽和カルボン酸（例えば、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、イソクロトン酸、マレイン酸）と脂肪族多価アルコール化合物とのエステル、不飽和カルボン酸と脂肪族多価アミン化合物とのアミドが挙げられる。またウレタン系付加重合性化合物も好適である。

#### 【0110】

光重合性組成物に含有される光重合開始剤としては、使用する光源の波長により、種々の光重合開始剤または2種以上の光重合開始剤の併用系（光開始系）を適宜選択して用いることができ、例えば、特開2001-22079号公報の〔

0021]～[0023]に記載されている開始系が好ましい。

光重合性組成物に含有される高分子結合剤は、光重合性組成物の皮膜形成剤として機能するだけでなく、感光層をアルカリ現像液に溶解させる必要があるため、アルカリ水に可溶性または膨潤性である有機高分子重合体が使用される。上記高分子結合剤としては同公報の[0036]～[0063]に記載されている物が有用である。

光重合性組成物には、同公報の[0079]～[0088]に記載されている添加剤（例えば塗布性を良化するための界面活性剤）を加えることが好ましい。

また、上記感光層の上に、酸素の重合禁止作用を防止するために酸素遮断性保護層を設けることが好ましい。酸素遮断性保護層に含有される重合体としては、ポリビニルアルコールおよびその共重合体が挙げられる。

更に上記の感光層の下塗層として、特開2001-228608号公報の[0131]～[0165]に記載されているような接着層を設けるのも好ましい。

#### 【0111】

##### ＜サーマルポジタイプ＞

サーマルポジタイプの感熱層は、アルカリ可溶性高分子化合物と光熱変換物質とを含有する。

アルカリ可溶性高分子化合物は、高分子中に酸性基を含有する単独重合体、これらの共重合体、およびこれらの混合物を包含し、特に、(1)フェノール性ヒドロキシ基( $-Ar-OH$ )、(2)スルホンアミド基( $-SO_2-NH-R$ )のような酸性基を有するものが、アルカリ現像液に対する溶解性の点で好ましい。とりわけ、赤外線レーザ等による露光での画像形成性に優れる点で、フェノール性ヒドロキシ基を有することが好ましい。例えば、フェノールホルムアルデヒド樹脂、m-クレゾールホルムアルデヒド樹脂、p-クレゾールホルムアルデヒド樹脂、m-/p-混合クレゾールホルムアルデヒド樹脂、フェノール/クレゾール(m-、p-およびm-/p-混合のいずれでもよい)混合ホルムアルデヒド樹脂等のノボラック樹脂；ピロガロールアセトン樹脂が好ましく挙げられる。更に詳しくは特開2001-305722号公報の[0023]～[0042]に記載されている高分子が好ましく用いられる。

## 【0112】

光熱変換物質は、露光エネルギーを熱に変換して感熱層の露光部領域の相互作用解除を効率よく行うことを可能とする。記録感度の観点から、波長700～1200nmの赤外域に光吸収域がある顔料または染料が好ましい。染料としては、具体的には、アゾ染料、金属錯塩アゾ染料、ピラゾロンアゾ染料、ナフトキノン染料、アントラキノン染料、フタロシアニン染料、カルボニウム染料、キノンイミン染料、メチソニン染料、シアニン染料、スクワリリウム色素、ピリリウム塩、金属チオレート錯体（例えば、ニッケルチオレート錯体）等が挙げられる。中でも、シアニン染料が好ましく、例えば、特開2001-305722号公報の一般式（I）で示されたシアニン染料が挙げられる。

サーマルポジタイプの感熱層に用いられる組成物には、前記コンベンショナルポジタイプで記述した物と同様の感度調節剤、焼出剤、染料等の化合物や塗布性を良化するための界面活性剤を加えることが好ましい。詳しくは特開2001-305722号公報の【0053】～【0059】に記載されている化合物が好ましい。

サーマルポジタイプの感熱層は単層であってもよいし、特開平11-218914号公報に記載されているような2層構造であってもよい。

サーマルポジタイプの感熱層と支持体との間には、下塗層を設けることが好ましい。下塗層に含有される成分としては特開2001-305722号公報の【0068】に記載されている種々の有機化合物が挙げられる。

## 【0113】

## &lt;サーマルネガタイプ&gt;

サーマルネガタイプの感熱層は、赤外線レーザ照射部が硬化して画像部を形成するネガ型の感熱層である。

このようなサーマルネガタイプの感熱層の一つとして、重合型の層（重合層）が好適に挙げられる。重合層は、（A）赤外線吸収剤と、（B）ラジカル発生剤（ラジカル重合開始剤）と、発生したラジカルにより重合反応を起こして硬化する（C）ラジカル重合性化合物と、（D）バインダーポリマーとを含有する。

重合層においては、赤外線吸収剤が吸収した赤外線を熱に変換し、この際発生

した熱により、オニウム塩等のラジカル重合開始剤が分解し、ラジカルが発生する。ラジカル重合性化合物は、末端エチレン性不飽和結合を有する化合物から選ばれ、発生したラジカルにより連鎖的に重合反応が生起し、硬化する。

(A) 赤外線吸収剤としては、例えば、前述したサーマルポジタイプの感熱層に含有される前記光熱変換物質が挙げられるが、特にシアニン色素の具体例としては特開2001-133969号公報の[0017]～[0019]に記載されたものが挙げられ、(B) ラジカル発生剤としては、オニウム塩が挙げられ、好適に用いられるオニウム塩の具体例としては、特開2001-133969号公報の[0030]～[0033]に記載されたものが挙げられ、(C) ラジカル重合性化合物は、末端エチレン性不飽和結合を少なくとも1個、好ましくは2個以上有する化合物から選ばれる。(D) バインダーポリマーとしては線状有機ポリマーを用いることが好ましく、水または弱アルカリ水に可溶性または膨潤性である線状有機ポリマーが選択される。特にこれらの中で、ベンジル基またはアリル基と、カルボキシ基とを側鎖に有する(メタ)アクリル樹脂が、膜強度、感度および現像性のバランスに優れており、好適である。(C) ラジカル重合性化合物および(D) バインダーポリマーに関しては同公報の[0036]～[0060]に詳しく記載された物が使用できる。その他の添加物としては、同公報の[0061]～[0068]に記載されている添加剤(例えば塗布性を良化するための界面活性剤)を加えることも好ましい。

〔0114〕

また、重合型のほかに、サーマルネガタイプの感熱層の一つとして、酸架橋型の層（酸架橋層）が好適に挙げられる。酸架橋層は、（E）光または熱により酸を発生する化合物（以下、「酸発生剤」という。）と、（F）発生した酸により架橋する化合物（以下、「架橋剤」という。）と、酸の存在下で架橋剤と反応し、（G）アルカリ可溶性高分子化合物を含有する。赤外線レーザのエネルギーを効率よく使用するため、酸架橋層には（A）赤外線吸収剤が配合される。（E）酸発生剤としては、光重合の光開始剤、色素類の光変色剤、マイクロレジスト等に使用されている酸発生剤等の、熱分解して酸を発生しうる化合物が挙げられる。（F）架橋剤としては、（i）ヒドロキシメチル基またはアルコキシメチル

基で置換された芳香族化合物、(i i) N-ヒドロキシメチル基、N-アルコキシメチル基またはN-アシルオキシメチル基を有する化合物、(i i i) エポキシ化合物が挙げられる。(G) アルカリ可溶性高分子化合物としては、ノボラック樹脂、側鎖にヒドロキシアリール基を有するポリマー等が挙げられる。

## 【0115】

## &lt;無処理タイプ&gt;

無処理タイプの感熱層は、熱可塑性微粒子ポリマー型、マイクロカプセル型、スルホン酸発生ポリマー含有型等のタイプがあり、本発明は特に印刷機上で現像する無処理タイプに好ましい。

熱可塑性微粒子ポリマー型は、(H) 疎水性熱溶融性樹脂微粒子が(J) 親水性高分子マトリックス中に分散され、露光部の熱により疎水性のポリマーが溶融し、互いに融着してポリマーによる疎水性領域、即ち、画像部を形成する。

(H) 疎水性熱溶融性樹脂微粒子(以下、「微粒子ポリマー」という。)は、微粒子ポリマー同士が熱により溶融合体するものが好ましく、表面が親水性で、湿し水等の親水性成分に分散する、親水性表面を有する微粒子ポリマーが好ましい。微粒子ポリマーとしては、Research Disclosure No. 33303(1992年1月)、特開平9-123387号、同9-13185号、同9-171249号、同9-171250号の各公報、欧州特許出願公開第931,647号明細書等に記載されている熱可塑性微粒子ポリマーが好適に挙げられる。具体例としては、エチレン、ステレン、塩化ビニル、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、塩化ビニリデン、アクリロニトリル、ビニルカルバゾール等のモノマーのホモポリマーもしくはコポリマーまたはそれらの混合物が挙げられる。中でも、ポリステレン、ポリメタクリル酸メチルを用いるのが好ましい。親水性表面を有する微粒子ポリマーは、微粒子を構成するポリマー自体が親水性であるもの、ポリマーの主鎖または側鎖に親水性基を導入して親水性を付与したもの等のポリマー自体が親水性であるもの;ポリビニルアルコール、ポリエチレングリコール等の親水性ポリマー、親水性オリゴマーまたは親水性低分子化合物を、微粒子ポリマー表面に吸着させて表面を親水性化したものを包含する。微粒子ポリマーとしては、熱反応

性官能基を有する微粒子ポリマーがより好ましい。上記したような微粒子ポリマーは、(J)親水性高分子マトリックス中に分散させることで、機上現像する場合には機上現像性が良好となり、更に感熱層自体の皮膜強度も向上する。

マイクロカプセル型としては、特開2000-118160号公報に記載されているタイプや、特開2001-277740号公報に記載されているような熱反応性官能基を有する化合物を内包するマイクロカプセル型が好ましく挙げられる。

#### 【0116】

スルホン酸発生ポリマー含有型に用いられるスルホン酸発生ポリマーとしては、例えば、特開平10-282672号公報に記載されているスルホン酸エスチル基、ジスルホン基またはsec-もしくはtert-スルホンアミド基を側鎖に有するポリマー等が挙げられる。

無処理タイプの感熱層に親水性樹脂を含有させることにより、機上現像性が良好となるばかりか、感熱層自体の皮膜強度も向上する。また、親水性樹脂を架橋して、現像処理不要の平版印刷版原版を得ることができる。親水性樹脂としては、例えば、ヒドロキシ基、カルボキシ基、ヒドロキシエチル基、ヒドロキシプロピル基、アミノ基、アミノエチル基、アミノプロピル基、カルボキシメチル基等の親水基を有するものや、親水性のゾルゲル変換系結着樹脂が好ましい。親水性樹脂の具体例としては、上記した(J)親水性高分子マトリックスとして用いられる親水性樹脂として列挙したものが挙げられる。

中でも、ゾルゲル変換系結着樹脂が好ましい。

無処理タイプの感熱層には、光熱変換物質を添加することが必要である。光熱変換物質は、波長700nm以上の光を吸収する物質であればよく、前記したサーマルポジタイプに用いられる染料と同様の染料が特に好ましい。

#### 【0117】

##### <バックコート層>

このようにして、本発明の平版印刷版用支持体上に、各種の画像記録層を設けて得られた本発明の平版印刷版原版の裏面には、必要に応じて、重ねた場合における画像記録層の傷付きを防止するために、有機高分子化合物からなるバックコ

ート層を設けることができる。

【0118】

＜塗布方法＞

上記コンベンショナルタイプ、フォトポリマータイプ、サーマルタイプ、および、無処理タイプの画像記録層形成液を上記平版印刷版用支持体の粗面化面に塗布する方法としては、コーティングロッドを用いる方法、エクストルージョン型コーティングを用いる方法、スライドビードコーティングを用いる方法等、従来公知の方法が使用でき、また公知の条件に従って行うことができる。

【0119】

上記コンベンショナルタイプ、フォトポリマータイプ、サーマルタイプ、および、無処理タイプの画像記録層形成液を塗布後のアルミニウム板を乾燥する装置としては、特開平6-63487号公報に記載の、乾燥装置内にパスロールを配置し、上記パスロールで搬送しつつ乾燥するアーチ型ドライヤー、上下からノズルによりエアーを供給し、ウェブを浮上させながら乾燥するエアードライヤー、高温に加熱された媒体からの輻射熱で乾燥する輻射熱ドライヤー、およびローラを加熱し、上記ローラとの接触による伝導伝熱により乾燥するローラドライヤー等がある。

【0120】

〔平版印刷版〕

本発明の平版印刷版原版は、画像記録層に応じた種々の処理方法により、平版印刷版とされる。

一般には、像露光を行う。像露光に用いられる活性光線の光源としては、例えば、水銀灯、メタルハライドランプ、キセノンランプ、ケミカルランプが挙げられる。レーザビームとしては、例えば、ヘリウム・ネオンレーザ（He-Neレーザ）、アルゴンレーザ、クリプトンレーザ、ヘリウム・カドミウムレーザ、KrFエキシマーレーザ、半導体レーザ、YAGレーザ、YAG-SHGレーザが挙げられる。

上記露光の後、画像記録層がサーマルタイプ、コンベンショナルタイプおよびフォトポリマータイプのいずれかである場合は、露光した後、現像液を用いて現

像して平版印刷版を得るのが好ましい。本発明の平版印刷版原版に用いられる好ましい現像液は、アルカリ現像液であれば特に限定されないが、有機溶剤を実質的に含有しないアルカリ性の水溶液が好ましい。また、アルカリ金属ケイ酸塩を実質的に含有しない現像液を用いて現像することもできる。アルカリ金属ケイ酸塩を実質的に含有しない現像液を用いて現像する方法については、特開平11-109637号公報に詳細に記載されており、該公報に記載されている内容を用いることができる。また、本発明の平版印刷版原版をアルカリ金属ケイ酸塩を含有する現像液を用いて現像することもできる。

## 【0121】

このようにして得られる平版印刷版は、インキや温し水の種類によらず、網点部のインキ絡みが発生しにくく耐放置汚れ性に優れ、更に、ポツ状残膜が発生しない。

## 【0122】

## 【実施例】

以下に実施例を示して本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限られるものではない。

## 【実施例1～11および比較例1～7】

## 1. 平版印刷版用支持体の作成

## &lt;アルミニウム板&gt;

Si: 0.08質量%、Fe: 0.3質量%、Cu: 0.001質量%、Ti: 0.015質量%を含有し、残部はA1と不可避不純物のアルミニウム合金を用いて溶湯を調製し、溶湯処理およびろ過を行った上で、厚さ500mm、幅1200mmの鋳塊をDC鋳造法で作成した。表面を平均10mmの厚さで面削機により削り取った後、550°Cで、約5時間均熱保持し、温度400°Cに下がったところで、熱間圧延機を用いて厚さ2.7mmの圧延板とした。更に、連続焼鈍機を用いて熱処理を500°Cで行った後、冷間圧延で、厚さ0.24mmに仕上げ、アルミニウム板を得た。このアルミニウム板を幅1030mmにした後、以下に示す表面処理に供した。

## 【0123】

＜表面処理＞

得られたアルミニウム板に、以下の（a）～（k）の各種表面処理を第1表に示す組み合わせで連続的に行い、実施例1～11および比較例1～7の平版印刷版用支持体を得た。各処理および水洗の後にはニップローラで液切りを行った。なお、第1表中、「-」は該当する表面処理を行わなかったことを表す。

【0124】

【表1】

第1表

	(a) 機械的 粗面化 処理	(b) アカリ イチジク 処理	(c) アスマト 処理	(d) 電気化学 的粗面化 処理	(e) アカリ イチジク 処理	(f) アスマト 処理	(g) 電気化学 的粗面化 処理	(h) アカリ イチジク 処理	(i) アスマト 処理	(j) 陽極酸化 処理	(k) シリカート 処理
実施例1	B-1	E-1	D-1	C-1	E-6	D-2	-	-	-	A-1	S-1
実施例2	B-2	E-1	D-1	C-1	E-6	D-2	M-3	E-9	D-2	A-1	S-1
実施例3	-	E-2	D-1	M-2	E-6	D-2	-	E-9	D-2	A-1	S-1
実施例4	B-3	E-1	D-1	C-1	E-6	D-2	-	E-9	D-2	A-1	S-1
実施例5	-	E-2	D-1	C-2	E-8	D-2	-	E-9	D-2	A-1	S-1
実施例6	B-1	E-1	D-1	C-2	E-4	D-2	-	E-11	D-2	A-1	S-1
実施例7	B-1	E-1	D-1	C-4	E-2	D-2	-	E-8	D-2	A-1	S-1
実施例8	B-1	E-1	D-1	C-1	E-6	D-2	-	-	-	A-1	S-1
実施例9	B-4	E-1	D-1	C-1	E-6	D-2	-	-	-	A-1	S-1
実施例10	B-5	E-1	D-1	C-1	E-6	D-2	-	-	-	A-1	S-1
実施例11	B-6	E-1	D-1	C-1	E-6	D-2	-	-	-	A-1	S-1
比較例1	B-1	E-1	D-1	M-2	E-9	D-2	-	-	-	A-1	S-1
比較例2	B-3	E-1	D-1	C-3	E-6	D-2	-	-	-	A-1	S-1
比較例3	-	E-2	D-1	M-2	E-4	D-2	-	-	-	A-1	S-1
比較例4	B-7	E-2	D-2	M-1	E-6	D-2	-	-	-	A-1	S-1
比較例5	B-8	E-2	D-2	M-1	E-6	D-2	-	-	-	A-1	S-1
比較例6	B-9	E-2	D-2	M-1	E-6	D-2	-	-	-	A-1	S-1
比較例7	B-10	E-1	D-1	C-1	E-6	D-2	-	-	-	A-1	S-1

## 【0125】

以下、各表面処理 (a) ~ (k) を説明する。

## 【0126】

## (a) 機械的粗面化処理 (ブラシグレイン法)

図1に示したような装置を使って、比重  $1.1 \text{ g/cm}^3$  のパミスの懸濁液を研磨スラリー液としてアルミニウム板の表面に供給しながら、回転する束植ブラシにより機械的粗面化処理を行った。図1において、1はアルミニウム板、2おしにより機械的粗面化処理を行った。図1において、1はアルミニウム板、2おし4はローラ状ブラシ (本実施例において、束植ブラシ)、3は研磨スラリーリー液、5、6、7および8は支持ローラである。

機械的粗面化処理は、研磨材のメジアン径 ( $\mu\text{m}$ )、ブラシ本数、ブラシの回転数 (r p m) を第2表に示す条件に変更した機械的粗面化処理条件 B-1 ~ B-10 で行なった。

束植ブラシの材質は6・10ナイロンで、ブラシ毛の直径 0.3 mm、毛長 5 mm であった。ブラシは、 $\phi 300 \text{ mm}$  のステンレス製の筒に穴をあけて密に 0 mm であった。束植ブラシ下部の2本の支持ローラ ( $\phi 200 \text{ mm}$ ) の距なるように植毛した。束植ブラシはブラシを回転させる駆動モータの負荷が離は 300 mm であった。束植ブラシはブラシを回転させる駆動モータの負荷が離は 300 mm であった。束植ブラシをアルミニウム板に押さえつける前の負荷に対して 10 kW プラス、束植ブラシをアルミニウム板に押さえつける前の負荷に対して 10 kW プラス、束植ブラシをアルミニウム板に押さえつけた。ブラシの回転方向はアルミニウム板の移動方向と同じになるまで押さえつけた。ブラシの回転方向はアルミニウム板の移動方向と同じになるまで押さえつけた。ブラシの回転方向はアルミニウム板の移動方向と同じになるまで押さえつけた。ブラシの回転方向はアルミニウム板の移動方向と同じになるまで押さえつけた。

なお、第2表の回転数は、アルミニウム板の搬送方向上流側 (図1において、右側) から順に、ブラシを1本目、2本目、3本目および4本目として表した。

## 【0127】

【表2】

第2表

条件	メジアン径 ( $\mu\text{m}$ )	ブラシ本数 (本)	回転数 (r pm)
B-1	30	4	1、3、4本目：250 2 本目：200
B-2	20	3	1 本目：250 2、3 本目：200
B-3	70	4	1、3、4本目：300 2 本目：250
B-4	60	4	1、3、4本目：250 2 本目：200
B-5	40	4	1、3、4本目：250 2 本目：200
B-6	38	3	1 本目：250 2、3 本目：200
B-7	80	4	1、3、4本目：250 2 本目：200
B-8	80	4	1、3、4本目：300 2 本目：250
B-9	50	4	1~4 本目：350
B-10	60	4	1~4 本目：300

【0128】

(b) アルカリエッティング処理

上記で得られたアルミニウム板を、第3表に示すカセイソーダ濃度（質量%）

、アルミニウムイオン濃度（質量%）のカセイソーダ水溶液を用いスプレーにより、第3表に示す溶解量（g/m<sup>2</sup>）でエッティング処理を行った。その後、スプレーによる水洗を行った。なおアルカリエッティング処理温度は、70℃であった。

## 【0129】

【表3】

第3表

条件	カセイソーダ 濃度（質量%）	A1イオン 濃度（質量%）	A1溶解量 (g/m <sup>2</sup> )
E-1	26	5	10
E-2	26	5	5
E-3	26	5	3
E-4	26	5	1
E-5	26	5	0.7
E-6	26	5	0.5
E-7	26	5	0.3
E-8	26	7	0.2
E-9	5	0.5	0.1
E-10	5	0.5	0.05
E-11	5	0.5	0.5

## 【0130】

## (c) デスマット処理

条件D-1：温度30℃の硝酸濃度1質量%水溶液（アルミニウムイオンを0.5質量%含む。）で、または、

条件D-2：温度60℃の硫酸濃度25質量%水溶液で、  
それぞれスプレーによるデスマット処理を行い、その後、スプレーで水洗した。  
デスマット処理に用いた硝酸水溶液は、硝酸水溶液中で交流を用いて電気化学的粗面化処理を行う工程の廃液を用いた。

## 【0131】

## (d) 電気化学的粗面化処理

## (d-1) 硝酸電解

60 Hz の交流電圧を用いて連続的に電気化学的な粗面化処理を行った。このときの電解液は、硝酸 1 質量% 水溶液（アルミニウムイオンを 0.5 質量% 含む。）、液温 50°C であった。交流電源波形は図 2 に示した波形であり、電流値がゼロからピークに達するまでの時間 TP が 0.8 msec、duty 比 1:1、台形の矩形波交流を用いて、カーボン電極を対極として電気化学的な粗面化処理を行った。補助アノードにはフェライトを用いた。電解槽は図 3 に示すものを使用した。

電流密度は電流のピーク値で  $30 \text{ A/dm}^2$  、補助陽極には電源から流れる電流の 5% を分流させた。電気量 ( $\text{C/dm}^2$ ) はアルミニウム板が陽極時の電気量の総和で第 4 表に示す値にした。

その後、スプレーによる水洗を行った。

【0132】

【表4】

第 4 表

条件	電気量 ( $\text{C/dm}^2$ )
C-1	175
C-2	220
C-3	400
C-4	60

【0133】

## (d-2) 塩酸電解

60 Hz の交流電圧を用いて連続的に電気化学的な粗面化処理を行った。液温 50°C であった。交流電源波形は図 2 に示した波形であり、電流値がゼロからピークに達するまでの時間 TP が 0.8 msec、duty 比 1:1、台形の矩形波交流を用いて、カーボン電極を対極として電気化学的な粗面化処理を行った。補助アノードにはフェライトを用いた。電解槽は図 3 に示すものを使用した。

電流密度は電流のピーク値で  $25 \text{ A/dm}^2$  であった。

塩酸電解に用いた電解液は第5表に示す塩酸濃度(質量%)の水溶液(アルミニウムイオンを0.5質量%含む。)であり、塩酸電解における電気量( $C/dm^2$ )はアルミニウム板が陽極時の電気量の総和で表し同様に第5表に示した。

その後、スプレーによる水洗を行った。

【0134】

【表5】

第5表

条件	塩酸濃度(質量%)	電気量( $C/dm^2$ )
M-1	1	400
M-2	1	600
M-3	0.5	50

【0135】

(e) アルカリエッティング処理

上記(b)で記載の条件でアルカリエッティング処理を行った。

【0136】

(f) デスマット処理

上記(c)で記載の条件D-2でデスマット処理を行った。

【0137】

(g) 電気化学的粗面化処理

上記(d-2)で記載の条件M-3で電気化学的粗面化処理を行った。その後、スプレーによる水洗を行った。

【0138】

(h) アルカリエッティング処理

上記(b)で記載の条件でアルカリエッティング処理を行った。その後、スプレーによる水洗を行った。

【0139】

(i) デスマット処理

上記(c)で記載の条件D-2でデスマット処理を行った。その後、スプレーによる水洗を行った。

## 【0140】

## (j) 陽極酸化処理(条件A-1)

図4に示す構造の直流電解による陽極酸化装置を用いて陽極酸化処理を行い、平版印刷版用支持体を得た。第一および第二電解部に供給した電解液としては、硫酸を用いた。電解液は、いずれも、硫酸濃度15質量% (アルミニウムイオンを0.5質量%含む。)、温度38°Cであった。その後、スプレーによる水洗を行った。最終的な酸化皮膜量は2.5 g/m<sup>2</sup>であった。

## 【0141】

## (k) シリケート処理(条件S-1)

35°Cの3号ケイ酸ソーダ水溶液 ( $\text{Na}_2\text{O} : \text{SiO}_2 = 1 : 3$ 、  $\text{SiO}_2$  含有量30質量%、日本化学工業社製、濃度1質量%) に10秒間ディップ処理した。その後井水を用いたスプレーによる水洗を行った。

## 【0142】

## 2. 平版印刷版用支持体の表面形状のファクターの算出

上記で得られた平版印刷版用支持体の表面について、以下のようにして表面積比  $\Delta S^{50(50)}$ 、  $\Delta S^{50(2-50)}$ 、  $\Delta S^{50(0.2-2)}$  および特定深さの凹部の数を測定した。

結果を第6表および第7表に示す。

## (1) 原子間力顕微鏡による表面形状の測定

①原子間力顕微鏡 (SP13700、セイコー電子工業社製) により表面形状を測定し、3次元データを求めた。以下、具体的な手順を説明する。

平版印刷版用支持体を1cm角の大きさに切り取って、ピエゾスキャナー上の水平な試料台にセットし、カンチレバーを試料表面にアプローチし、原子間力が働く領域に達したところで、XY方向にスキャンし、その際、試料の凹凸をZ方向のピエゾの変位でとらえた。ピエゾスキャナーは、XY方向について150μm、Z方向について10μm、走査可能なものを使用した。カンチレバーは共振周波数120~400kHz、バネ定数12~90N/mのもの (S1-DF2

0、セイコーインスツルメンツ社製)を用い、DFMモード(Dynamic Force Mode)で測定した。また、求めた3次元データを最小二乗近似することにより試料のわずかな傾きを補正し基準面を求めた。

計測の際は、表面の $50\text{ }\mu\text{m}$ 口を $512 \times 512$ 点測定した。XY方向の分解能は $0.1\text{ }\mu\text{m}$ 、Z方向の分解能は $1\text{ nm}$ 、スキャン速度は $60\text{ }\mu\text{m/sec}$ とした。

## 【0143】

② $\Delta S^{50}$ の測定

上記①で求められた3次元データ( $f(x, y)$ )を用い、隣り合う3点を抽出し、その3点で形成される微小三角形の面積の総和を求め、実面積 $S_x^{50}$ とした。表面積比 $\Delta S^{50}$ は、得られた実面積 $S_x^{50}$ と幾何学的測定面積 $S_0^{50}$ とから、下記式により求めた。

$$\Delta S^{50} = [(S_x^{50} - S_0^{50}) / S_0^{50}] \times 100\text{ (%)}$$

(i)  $\Delta S^{50(50)}$ の算出には上記①で求められた3次元データをそのまま用いた

(ii) 表面積比 $\Delta S^{50(2-50)}$ の算出には、上記①で求められた3次元データから波長 $2\text{ }\mu\text{m}$ 以上 $50\text{ }\mu\text{m}$ 以下の成分を抽出したものを用いた。波長 $2\text{ }\mu\text{m}$ 以上 $50\text{ }\mu\text{m}$ 以下の成分の抽出には、上記①で求められた3次元データを高速フーリエ変換をして周波数分布を求め、ついで、波長 $2\text{ }\mu\text{m}$ 未満の成分を除去した後、フーリエ逆変換をすることにより行った。

(iii) 表面積比 $\Delta S^{50(0.2-2)}$ の算出には、上記①で求められた3次元データから波長 $0.2\text{ }\mu\text{m}$ 以上 $2\text{ }\mu\text{m}$ 以下の成分を抽出したものを用いた。波長 $0.2\text{ }\mu\text{m}$ 以上 $2\text{ }\mu\text{m}$ 以下の成分の抽出には、上記①で求められた3次元データを高速フーリエ変換をして周波数分布を求め、ついで、波長 $0.2\text{ }\mu\text{m}$ 未満の成分および $2\text{ }\mu\text{m}$ 超の成分を除去した後、フーリエ逆変換をすることにより行った。

## 【0144】

## (2) 特定深さの凹部の数

特定深さの凹部の数は、実施例8～11および比較例4～7の平版印刷版用支持体について求めた。

①深さ  $4 \mu\text{m}$  以上の凹部の数

レーザ顕微鏡 (Micro map 520、(株) 菱化システム製) を用いて表面の  $400 \mu\text{m} \times 400 \mu\text{m}$  を非接触で  $0.01 \mu\text{m}$  走査して 3 次元データを求め、この 3 次元データにおいて深さ  $4 \mu\text{m}$  以上の凹部の数を数えた。

なお、レーザ顕微鏡としては、上記で用いたもののほか、例えば、(株) KEYENCE 製の超深度形状測定顕微鏡 VK5800 も同様に用いることができる。第 7 表において、該凹部の数を「Dpn (4  $\mu\text{m}$ )」と表示する。

②深さ  $3 \mu\text{m}$  以上の凹部の数

同様に 3 次元データを求め、深さ  $3 \mu\text{m}$  以上の凹部の数を数えた。なお、第 7 表において、該凹部の数を「Dpn (3  $\mu\text{m}$ )」と表示する。

## 【0145】

## 3. 平版印刷版原版の作成

上記で得られた各平版印刷版用支持体に、サーマルポジタイプの画像記録層を設けて平版印刷版原版を得た。各画像記録層を設ける前には、以下の条件で下塗処理の界面処理を行った。

## 【0146】

上記のようにして得られたアルカリ金属ケイ酸塩処理後の平版印刷版用支持体上に、下記組成の下塗液を塗布し、 $80^\circ\text{C}$  で 15 秒間乾燥し、塗膜を形成させた。乾燥後の塗膜の被覆量は  $10 \text{ mg/m}^2$  であった。

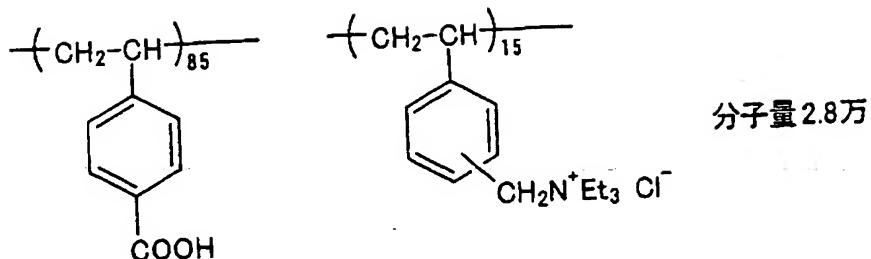
## 【0147】

## &lt;下塗液組成&gt;

・下記高分子化合物	0.2 g
・メタノール	100 g
・水	1 g

## 【0148】

## 【化1】



## 【0149】

更に、下記組成の感熱層塗布液を調製し、下塗りした平版印刷版用支持体に、この感熱層塗布液を乾燥後の塗布量（感熱層塗布量）が1.7 g / m<sup>2</sup> になるよう塗布し、乾燥させて感熱層（サーマルポジタイプの画像記録層）を形成させ、平版印刷版原版を得た。

## 【0150】

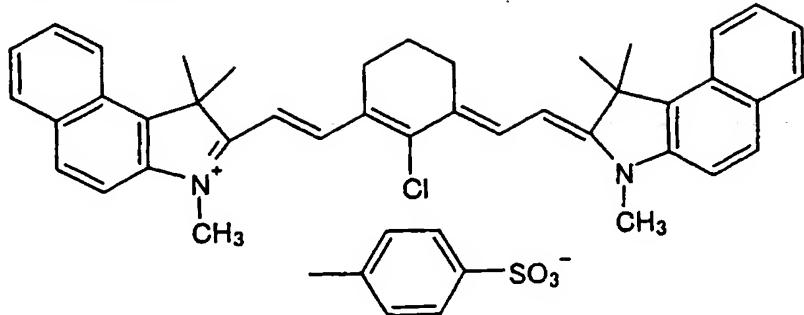
## &lt;感熱層塗布液組成&gt;

・ノボラック樹脂 (m-クレゾール / p-クレゾール = 60 / 40、重量平均分子量7,000、未反応クレゾール0.5質量%含有)	1.0 g
・下記構造式で表されるシアニン染料A	0.1 g
・テトラヒドロ無水フタル酸	0.05 g
・p-トルエンスルホン酸	0.002 g
・エチルバイオレットの対イオンを6-ヒドロキシ-β-ナフタレンスルホン酸にしたもの	0.02 g
・フッ素系界面活性剤 (メガファックF-177、大日本インキ化学工業社製)	0.05 g
)	1.2 g
・メチルエチルケトン	

## 【0151】

## 【化2】

シアニン染料A



## 【0152】

## 4. 露光および現像処理

上記で得られた各平版印刷版原版には、下記の方法で画像露光および現像処理を行い、平版印刷版を得た。

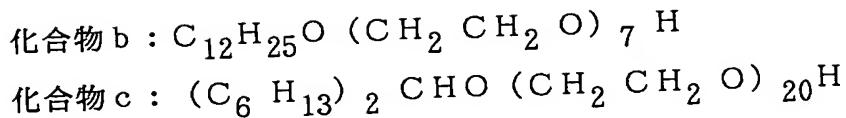
## 【0153】

平版印刷版原版を出力500mW、波長830nmビーム径17μm(1/e<sup>2</sup>)の半導体レーザーを装備したCREO社製Trend Setter 324を用いて主走査速度5m/秒、版面エネルギー量140mJ/cm<sup>2</sup>で像様露光した。

その後、非還元糖と塩基とを組み合わせたD-ソルビット/酸化カリウムK<sub>2</sub>Oよりなるカリウム塩5.0質量%およびオルフィンAK-02(日信化学社製)0.015質量%を含有する水溶液1Lに下記化合物a 1.0gを添加したアルカリ現像液(現像液1)を用いて現像処理を行った。現像処理は、現像液1を満たした自動現像機PS900NP(富士写真フィルム(株)製)を用いて、現像温度25°C、12秒の条件で行った。現像処理が終了した後、水洗工程を経て、ガム(GU-7(1:1))等で処理して、製版が完了した平版印刷版を得た。なお、化合物aの代わりに、下記化合物bまたはcと同じ添加量で添加したアルカリ現像液を用いた場合であっても、同様に現像処理を行うことができた。

## &lt;化合物a～c&gt;

化合物a: C<sub>12</sub>H<sub>25</sub>N(CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>COONa)<sub>2</sub>



## 【0154】

## 5. 平版印刷版の評価

上記で得られた平版印刷版について、インキの絡み難さ、耐放置汚れ性、耐汚れ性およびポツ状残膜の発生の有無を下記の方法で評価した。

なお、耐汚れ性は、地汚れにより評価した。

## (1) インキの絡み難さ

ハイデルベルグ社製のSOR-M印刷機で、大日本インキ化学工業社製のDI C-GEOS (H) 墨を用いて、湿し水を少なくすることで、網部におけるインキの絡みを程度により10段階で評価した。結果を第6表および第7表に示す。数字が大きいほどインキの絡み難さに優れることを示す。評価が5以上であれば、インキの絡み難さに優れる。

## 【0155】

## (2) 耐放置汚れ性

上記インキの絡み難さの評価において、1万枚印刷した後、低湿度環境下（具体的には、50RH%）で、版を1時間放置し、その後、再度印刷を開始して、網点部分の汚れを程度により10段階で評価した。結果を第6表および第7表に示す。数字が大きいほど耐放置汚れ性に優れることを示す。評価が5以上であれば、耐放置汚れ性に優れる平版印刷版として、実用できるレベルにある。

## 【0156】

## (3) 耐汚れ性（地汚れ）

印刷試験において、印刷機の水目盛りを調整し、地汚れの生じる水目盛りにより地汚れを評価した。地汚れの生じる水目盛りが2未満である場合を○、2以上3未満である場合を○△、3以上4未満である場合を△、4以上である場合を×とした。評価が○△以上であれば、耐汚れ性に優れる。

## 【0157】

## (4) ポツ状残膜の発生の有無

各版面エネルギー量で露光したサンプルの現像後の非画像部を光学顕微鏡で倍

率100倍で観察し、1mm四方の面積におけるポツ状残膜の有無を調べた。ポツ状残膜が観察されないサンプルの版面エネルギー量の最小値により、12段階でポツ状残膜の発生の有無を評価した。結果を第6表および第7表に示す。

版面エネルギー量が小さいほど、即ち、評価の数字が大きいほどポツ状残膜が発生しにくいことを示す。

## 【0158】

第6表および第7表から明らかなように、原子間力顕微鏡を用いて、表面の50μm口を512×512点測定して求められる3次元データから得られる、上記 $\Delta S^{50(50)}$ 、 $\Delta S^{50(2-50)}$ 、および、 $\Delta S^{50(0.2-2)}$ が本発明の範囲にある平版印刷版用支持体（実施例1～11）は親水性および保水性を改善でき、それを用いた平版印刷版原版は、平版印刷版としたときに、網点部のインキ絡みが発生しにくく低温度環境下における耐放置汚れ性に優れる。

また、上記表面積比 $\Delta S^{50}$ を持つ平版印刷版用支持体の表面に存在する特定の深さを有する凹部の数が本発明の範囲にある平版印刷版用支持体（実施例8～11）は、上記特性に加えて、露光および現像の条件を厳しくしてもポツ状残膜の発生が特に抑えられる。

## 【0159】

【表6】

第6表

	表面積比△S			インキの 絡み難さ	耐放置 汚れ性	耐汚れ性
	△S <sup>50(50)</sup>	△S <sup>50(2-50)</sup>	△S <sup>50(0.2-2)</sup>			
実施例1	50	6	35	9	8	○
実施例2	40	5	26	7	7	○
実施例3	30	10	18	8	7	○
実施例4	85	28	38	10	7	○△
実施例5	38	3	39	6	8	○
実施例6	24	6	23	9	9	○
実施例7	22	4	7	7	9	○
比較例1	60	19	42	5	4	○
比較例2	90	32	40	10	7	×
比較例3	15	10	3	4	3	○

【0160】

【表7】

表 7 第

	Dpn (3 μm)	Dpn (4 μm)	表面積比 $\Delta S$			インキの 絡み難さ	耐放置 汚れ性	耐汚れ性	ポツ状 発生の有無
			$\Delta S^{50(50)}$	$\Delta S^{50(2-50)}$	$\Delta S^{50(0.2-2)}$				
実施例8	1.5	5	5.0	6	3.5	9	8	○	8
実施例9	2.1	8	5.5	1.0	3.6	9	8	○	7
実施例10	1.1	1.5	4.9	5	3.3	9	8	○	9
実施例11	8	0.8	3.8	6	2.8	7	7	○	11
比較例4	2.9	1.0	6.0	3.2	3.0	9	8	×	5
比較例5	3.5	1.1	6.0	3.2	3.8	9	8	×	1
比較例6	3.3	1.0	6.2	3.3	4.0	9	6	×	1
比較例7	2.9	1.2	5.8	2.5	3.6	9	8	△	4

【0161】

【発明の効果】

以上に説明したように、表面形状に特徴を有する本発明の平版印刷版用支持体を用いれば、平版印刷版としたときに、インキや湿し水の種類によらず、網点部のインキ絡みが発生しにくく低湿度環境下における耐放置汚れ性に優れる。

【0162】

また、本発明の平版印刷版用支持体を用いれば、平版印刷版としたときに、上記特性に加えて、更に、ポツ状残膜の発生も抑えられる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の平版印刷版用支持体の作成における機械粗面化処理に用いられるブラシグレイニングの工程の概念を示す側面図である。

【図2】 本発明の平版印刷版用支持体の作成における電気化学的粗面化処理に用いられる交番波形電流波形図の一例を示すグラフである。

【図3】 本発明の平版印刷版用支持体の作成における交流を用いた電気化学的粗面化処理におけるラジアル型セルの一例を示す側面図である。

【図4】 本発明の平版印刷版用支持体の作成における陽極酸化処理に用いられる陽極酸化処理装置の概略図である。

【符号の説明】

- 1 アルミニウム板
- 2、4 ローラ状ブラシ
- 3 研磨スラリー液
- 5、6、7、8 支持ローラ
- 11 アルミニウム板
- 12 ラジアルドラムローラ
- 13 a、13 b 主極
- 14 電解処理液
- 15 電解液供給口
- 16 スリット
- 17 電解液通路

18 補助陽極

19a、19b サイリスタ

20 交流電源

40 主電解槽

50 補助陽極槽

410 陽極酸化処理装置

412 納電槽

414 電解処理槽

416 アルミニウム板

418、426 電解液

420 納電電極

422、428 ローラ

424 ニップローラ

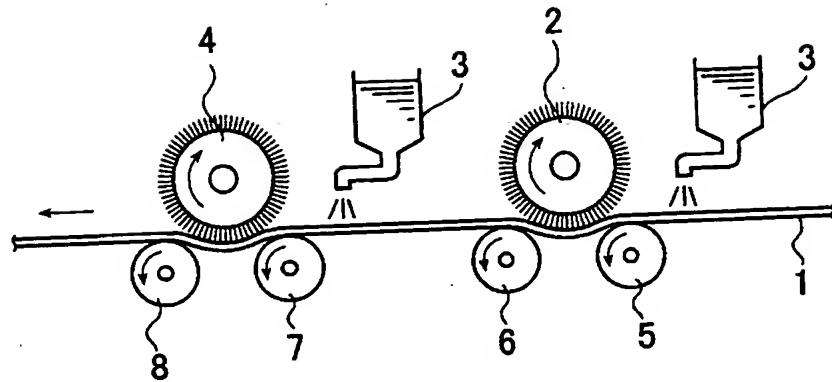
430 電解電極

432 槽壁

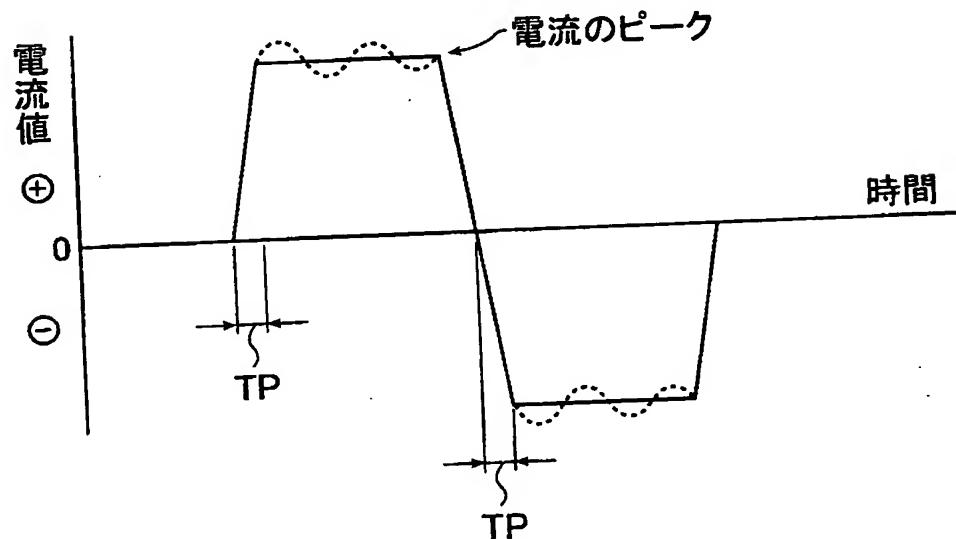
434 直流電源

【書類名】 図面

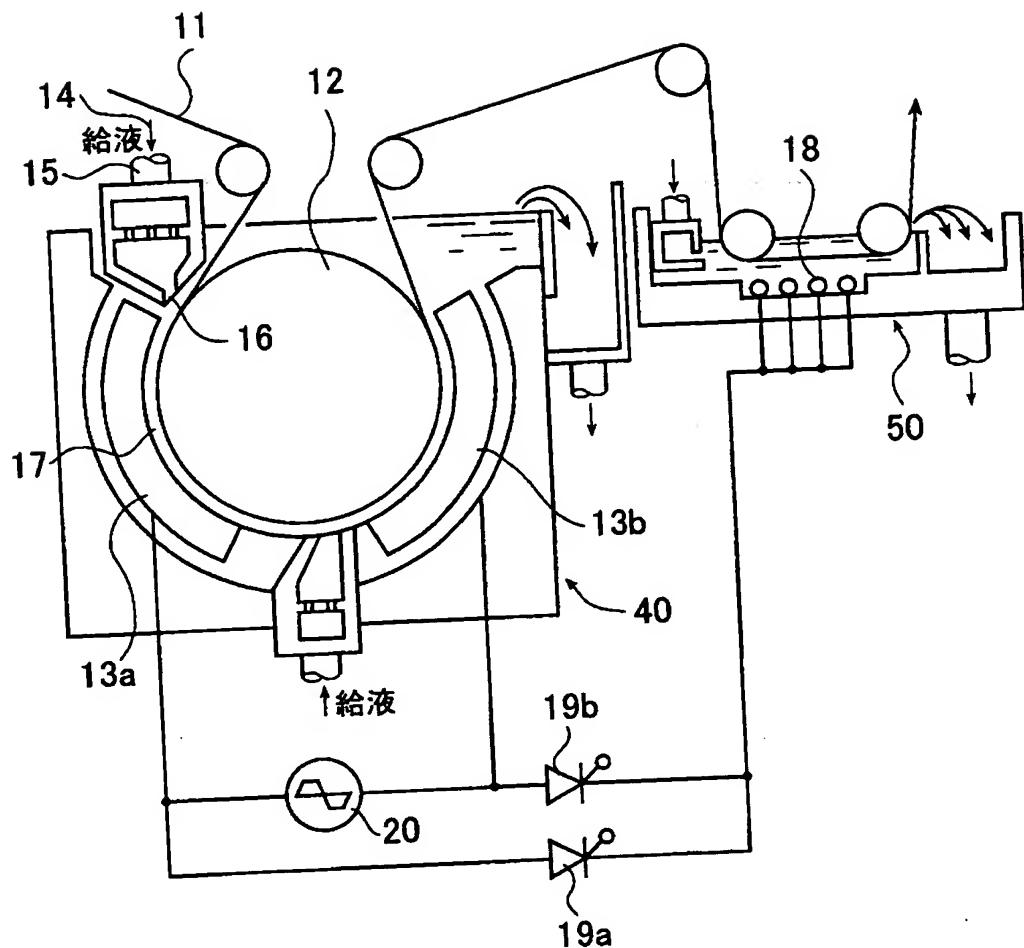
【図1】



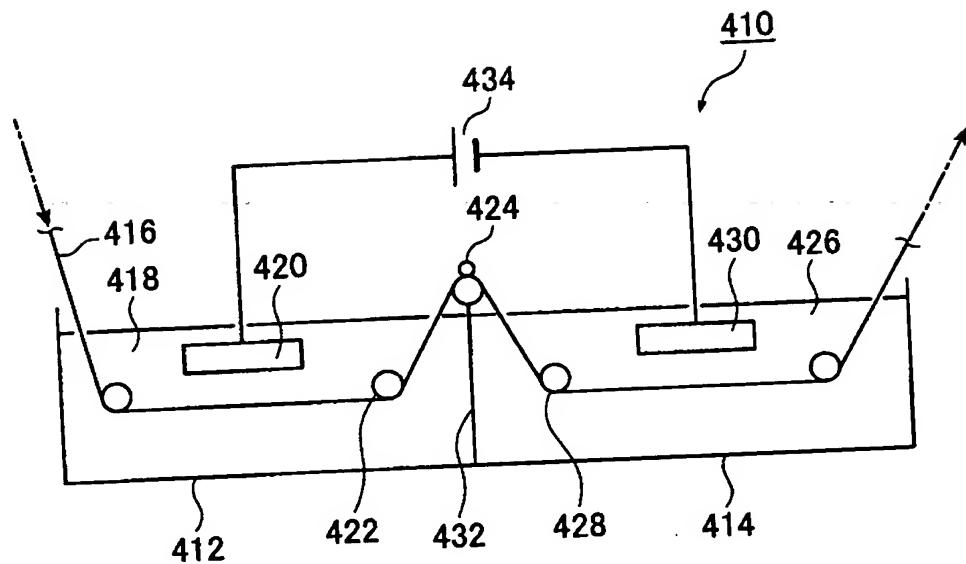
【図2】



【図3】



【図4】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 平版印刷版としたときに、インキや湿し水の種類によらず、網点部のインキ絡みが発生しにくく耐放置汚れ性に優れる平版印刷版用支持体およびそれを用いる平版印刷版原版の提供。

【解決手段】 原子間力顕微鏡を用いて、表面の  $50 \mu\text{m}$  口を  $512 \times 512$  点測定して求められる 3 次元データより得られる表面積比  $\Delta S^{50}$  が、下記条件 (i) ~ (i i i) を満足する平版印刷版用支持体およびそれを用いる平版印刷版原版。

(i) 表面積比  $\Delta S^{50(50)}$  が  $20 \sim 90\%$

(i i) 表面積比  $\Delta S^{50(2-50)}$  が  $1 \sim 30\%$

(i i i) 表面積比  $\Delta S^{50(0.2-2)}$  が  $5 \sim 40\%$

【選択図】 なし

出願人履歴情報

識別番号 [000005201]

1. 変更年月日 1990年 8月14日

[変更理由] 新規登録

住 所 神奈川県南足柄市中沼210番地  
氏 名 富士写真フィルム株式会社